Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/003688

International filing date: 25 February 2005 (25.02.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-273996

Filing date: 21 September 2004 (21.09.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 14 April 2005 (14.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

25.02.2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2004年 9月21日

出 願 番 号 Application Number:

特願2004-273996

[ST. 10/C]:

[JP2004-2739.96]

出 願 人
Applicant(s):

富士写真フイルム株式会社

特許庁長官 Commissioner,

Japan Patent Office

2005年 3月31日







ページ: 1/E

【書類名】 特許願

【整理番号】 PF04314834

【提出日】 平成16年 9月21日

【あて先】 特許庁長官 小川 洋 殿

【国際特許分類】 G02B 1/00 G02B 5/30 G02F 1/13

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真フイルム株式会社内

【氏名】 大軽 郁子

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地 富士写真フイルム株式

会社内

【氏名】 柳 輝一

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真フイルム株式会社内

【氏名】 川本 博之

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真フイルム株式会社内

【氏名】 深川 伸隆

【特許出願人】

【識別番号】 000005201

【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【代理人】

【識別番号】 100076439

【弁理士】

【氏名又は名称】 飯田 敏三

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2004-52562 【出願日】 平成16年2月26日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 016458 【納付金額】 16,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

 【物件名】
 明細書 1

 【物件名】
 要約書 1

 【包括委任状番号】
 9800119

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

セルロースアシレートと、該セルロースアシレート100質量部に対して下記一般式(I) で表される化合物の少なくとも一種 0. 01乃至20質量部および該セルロースアシ レート100質量部に対して少なくとも3つの置換基を有する環状化合物の少なくとも一 種0.01乃至20質量部とを含むことを特徴とする光学補償シート。

【化1】

--般式(I)

$$R^{3}$$
 R^{4}
 R^{5}
 R^{10}
 R^{10}
 R^{9}
 R^{8}

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^9 および R^{1} 0 はそれぞれ独立に水素原 子または置換基を表し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 および R^5 のうち少なくとも1つは電子供与性 基を表す。 R^8 は水素原子、炭素数 $1\sim4$ のアルキル基、炭素数 $2\sim6$ のアルケニル基、炭 素数 $2 \sim 6$ のアルキニル基、炭素数 $6 \sim 1$ 2 のアリール基、炭素数 $1 \sim 1$ 2 のアルコキシ 基、炭素数6~12のアリールオキシ基、炭素数2~12のアルコキシカルボニル基、炭 素数2~12のアシルアミノ基、シアノ基またはハロゲン原子を表す。)

【請求項2】

Reレターデーション値が20乃至200nmであり、Rthレターデーション値が70 乃至400nmであることを特徴とする請求項1に記載の光学補償シート。

【請求項3】

Reレターデーション値が20乃至70nmであり、Rthレターデーション値が70乃 至400 nmであることを特徴とする請求項1または2に記載の光学補償シート。

【請求項4】

Reレターデーション値とRthレターデーション値との比(Re/Rth比)が0. 1乃至0.8であることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の光学補償シー 卜。

【請求項5】

膜厚が 20 μ m \sim 160 μ m の一枚のセルロースアシレートフイルムのみからなること を特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の光学補償シート。

【請求項6】

700mmでのReレターデーション値(Re700)と400mmでのReレターデ ーションの値(R e 4 0 0)の差(R e 7 0 0 - R e 4 0 0)が- 2 5 nm乃至 1 0 nmであ ることを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の光学補償シート。

【請求項7】

7 0 0 n m でのR t h レターデーション値 (R t h 7 0 0) と 4 0 0 n m でのR t h レ ターデーションの値(Rth400)の差(Rth700-Rth400)が-50nm 乃至20 nmであることを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の光学補償シー **卜** 。

【請求項8】

25℃10% R H 環境下で測定した R e レターデーション値、 R t h レターデーション 値と25℃80%RH環境下で測定したReレターデーション値、Rthレターデーショ ン値の差異が、それぞれ25 nm以内、70 nm以内であることを特徴とする請求項1~ 7のいずれか1項に記載の光学補償シート。

【請求項9】

25℃90%RHでの透湿度が20g/m² ・24hr乃至250g/m² ・24hr

であることを特徴とする請求項1~8のいずれか1項に記載の光学補償シート。

【請求項10】

90℃乾燥条件下での寸度変化が-0.15%以内であることを特徴とする請求項1~ 9のいずれか1項に記載の光学補償シート。

【請求項11】

60℃90%RHでの寸度変化が-0.15%以内であることを特徴とする請求項1~ 10のいずれか1項に記載の光学補償シート。

表面エネルギーが55乃至75mN/mであるセルロースアセテートフイルムからなる ことを特徴とする請求項1~11のいずれか1項に記載の光学補償シート。

【請求項13】

偏光板保護膜として使用した場合の60℃95%RH雰囲気下500時間経時後の偏光 度の低下が3%以内であることを特徴とする請求項1~12のいずれか1項に記載の光学 補償シート。

【請求項14】

3乃至100%の延伸倍率で延伸したセルロースアシレートフイルムからなることを特 徴とする請求項1~13のいずれか1項に記載の光学補償シート。

【請求項15】

セルロースアシレートが、酢化度が59.0乃至61.5%であるセルロースアセテー トであり、延伸倍率1%あたりのRe/Rth変化量が0.01乃至0.1であることを 特徴とする請求項1~14のいずれか1項に記載の光学補償シート。

【請求項16】

長手方向に搬送しながら長手方向と直交する方向に延伸し、延伸開始時のセルロースア シレートフイルムの残留溶剤量が2%乃至50%の状態であり、該フィルムの遅相軸が該 フィルムの長尺方向に対して直交する方向にあることを特徴とする請求項1~15のいず れか1項に記載の光学補償シート。

【請求項17】

セルロースアシレートフィルムが、セルロースの水酸基がアセチル基および炭素原子数 が $3\sim 2$ 2 の アシル基で置換されたセルロースアシレートからなり、かつ該セルロースア シレートのアセチル基の置換度Aおよび炭素原子数が3~22のアシル基の置換度Bが、 下記式 (VI) および (VII) を満たすことを特徴とする請求項 $1\sim 16$ のいずれか1項に 記載の光学補償シート。

式 (VI) : 2. $0 \le A + B \le 3$. 0

式 (VII) : 0 < B

【請求項18】

炭素原子数が3~22のアシル基が、ブタノイル基またはプロピオニル基であることを 特徴とする請求項17に記載の光学補償シート。

【請求項19】

セルロースを構成するグルコース単位の水酸基を炭素原子数が2以上のアシル基で置換 して得られたセルロースアシレートからなるフィルムであって、セルロースを構成するグ ルコース単位の2位の水酸基のアシル基による置換度をDS2、3位の水酸基のアシル基 による置換度をDS3、6位の水酸基のアシル基による置換度をDS6としたときに、下 記式(XII)および(XIII)を満たすセルロースアシレートフィルムであることを特徴と する請求項1~18のいずれか1項に記載の光学補償シート。

数式 (XII) : 2. 0 ≤ D S 2 + D S 3 + D S 6 ≤ 3. 0

数式 (XIII) : DS6/(DS2+DS3+DS6) ≥0.315

【請求項20】

アシル基がアセチル基であることを特徴とする請求項19に記載の光学補償シート。

【請求項21】

少なくとも3つの置換基を有する環状化合物が、一般式(II)で表される化合物である

ことを特徴とする請求項1の光学補償シート。

化2

一般式(I)

(式中、 X^1 は、単結合、 $-NR^4$ -、-O-または-S-をあらわし、; X^2 は、単結 合、 $-NR^5$ -、-O-または-S-をあらわし、; X^3 は、単結合、 $-NR^6$ -、-O-または-S-をあらわし、; R^1 、 R^2 および R^3 は、それぞれ独立に、アルキル基、 アルケニル基、アリール基または複素環基をあらわし;そして、 \mathbb{R}^4 、 \mathbb{R}^5 および \mathbb{R}^6 は 、それぞれ独立に、水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基または複素環基を あらわす。)

【請求項22】

偏光膜およびその両側に配置された二枚の透明保護膜からなる偏光板であって、透明保 護膜の少なくとも一方が、請求項1~21のいずれか1項に記載の光学補償シートである ことを特徴とする偏光板。

【請求項23】

前記光学補償シートと反対側の透明保護膜には少なくとも光散乱層と低屈折率層からな る鏡面反射率2.5%以下の反射防止層を設けたことを特徴とする請求項22に記載の偏 光板。

【請求項24】

前記光学補償シートと反対側の透明保護膜には少なくとも中屈折率層、高屈折率層、低 屈折率層がこの順に積層されてなる鏡面反射率 0.5%以下の反射防止層を設けたことを 特徴とする請求項22または23に記載の偏光板。

【請求項25】

液晶セルおよびその両側に配置された二枚の偏光板からなり、該偏光板が偏光膜および その両側に配置された二枚の透明保護膜からなる液晶表示装置であって、該液晶セルと少 なくとも一方の偏光板との間に、請求項1~21のいずれか1項に記載の光学補償シート が配置されており、該セルロースアシレートフイルムの遅相軸とセルロースアシレートフ イルムに隣接する偏光膜の透過軸とが実質的に平行になるように配置されていることを特 徴とする液晶表示装置。

【請求項26】

液晶セルおよびその両側に配置された二枚の偏光板からなり、該偏光板が偏光膜および その両側に配置された二枚の透明保護膜からなる液晶表示装置であって、該液晶セルと少 なくとも一方の偏光板との間に、請求項 $1 \sim 21$ のいずれか1項に記載の光学補償シート が配置されており、該セルロースアシレートフイルムの遅相軸とセルロースアシレートフ イルムに隣接する偏光膜の透過軸とが実質的に平行になるように配置されていることを特 徴とするVAモードの液晶表示装置。

【請求項27】

液晶セルおよびその両側に配置された二枚の偏光板からなり、該偏光板が偏光膜および その両側に配置された二枚の透明保護膜からなる液晶表示装置であって、該液晶セルと観 察者側、バックライト側それぞれの偏光板との間に、請求項1~21のいずれか1項に記 載の光学補償シートが配置されており、該セルロースアシレートフイルムの遅相軸とセル ロースアシレートフイルムに隣接する偏光膜の透過軸とが実質的に平行になるように配置 されていることを特徴とするVAモードの液晶表示装置。

【請求項28】

液晶セルおよびその両側に配置された二枚の偏光板からなり、該偏光板が偏光膜および その両側に配置された二枚の透明保護膜からなる液晶表示装置であって、該液晶セルと観 察者側、あるいは、該液晶セルとバックライト側のいずれか一方の偏光板との間に、請求 項 $1 \sim 2$ 1のいずれか1項に記載の光学補償シートが配置されており、該セルロースアシ レートフイルムの遅相軸とセルロースアシレートフイルムに隣接する偏光膜の透過軸とが 実質的に平行になるように配置されていることを特徴とするVAモードの液晶表示装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】光学補償シート、偏光板および液晶表示装置

【技術分野】

[0001]

本発明は、一枚のセルロースアシレートフイルムのみからなる光学補償シートおよびそ れを用いた偏光板と液晶表示装置とに関する。

【背景技術】

[0002]

セルロースフイルム中でも、セルロースアセテートフイルムは、他のポリマーフイルム と比較して、光学的等方性が高い(レターデーション値が低い)との特徴がある。従って 、光学的等方性が要求される用途、例えば偏光板には、セルロースアセテートフイルムを 用いることが普通である。一方、液晶表示装置等の光学補償シート(位相差フイルム)に は、逆に光学的異方性(高いレターデーション値)が要求される。従って、光学補償シー トとしては、ポリカーボネートフイルムやポリスルホンフイルムのようなレターデーショ ン値が高い合成ポリマーフイルムを用いることが普通であった。

[0003]

以上のように光学材料の技術分野では、ポリマーフイルムに光学的異方性(高いレター デーション値)が要求される場合には合成ポリマーフイルムを使用し、光学的等方性(低 いレターデーション値)が要求される場合にはセルロースアセテートフイルムを使用する ことが一般的であった。

$[0\ 0\ 0\ 4\]$

しかし近年、光学的異方性が要求される用途にも使用できる高いレターデーション値を 有するセルロースアセテートフイルムが要求され、それに対応した技術が提案されている (例えば特許文献1)。該公開発明ではセルローストリアセテートで高いレターデーショ ン値を実現するために、少なくとも2つの芳香環を有する芳香族化合物、中でも1,3, 5-トリアジン環を有する化合物を添加し、延伸処理を行っている。

一般にセルローストリアセテートは延伸しにくい高分子素材であり、複屈折率を大きく することは困難であることが知られているが、上記特許文献1では添加剤を延伸処理で同 時に配向させることにより複屈折率を大きくすることを可能にし、高いレターデーション 値を実現している。このフィルムは偏光板の保護フィルムを兼ねることができるため、安 価で薄膜な液晶表示装置を提供することができる利点がある。

[0005]

近年、液晶表示装置の軽量化、製造コスト低減のために液晶セルの薄膜化が必須となっ ている。そのために光学補償シートに必要とされる光学性能はより高いReレターデーシ ョン値であって、より低いRthレターデーション値であるフィルムが必要となってきて いる。

しかしながら、本発明者が特許文献1で開示された方法で鋭意検討した結果、該手法で は、前述のReレターデーション値とRthレターデーション値を個々に設定しようとし た場合にそれらを両立することができない問題があることが判明した。上記欧州特許以外 にもVA用位相差フィルムの光学性能についての技術を開示している特許文献、例えば特 許文献2があるが、所望のRe値とRth値を両立する方法については明示されていなか った。

[0006]

【特許文献1】欧州特許出願公開0911656A2号明細書

【特許文献2】特開2001-116926号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0007]

本発明の目的は、セルロースアシレートフイルムのみで、液晶セルを光学的に補償する 光学補償シートを提供することである。

本発明の別の目的は、構成要素の数を増加することなく、偏光板に液晶表示装置に最適な光学補償機能が追加された偏光板を提供することである。

本発明のさらなる別の目的は、セルロースアシレートフイルムによって光学的に補償された液晶表示装置を提供することである。

[0008]

まず、前記特許文献1に開示の手法で高Re/Rth比が実現できない理由を説明する

一定の膜厚で考えた場合、フィルムのレターデーションは素材の屈折率と存在量、配向 状態によって決まる。前記特許文献1に開示された方法の場合、セルローストリアセテー トの3軸の屈折率と配向状態、添加剤である円盤状化合物の屈折率、添加量、配向状態に より決まる。その他の添加剤、例えば可塑剤などもレターデーション発現に若干影響する が、その効果は概ね小さいため省略する。

セルローストリアセテートは、一般に延伸しにくい素材であるため延伸倍率を大きくすることが難しく、大きいレターデーション値を実現しにくい。特許文献1のようにセルローストリアセテートを用いて高いレターデーションを実現した場合、発現したレターデーションは添加剤の寄与が大きい。

Reレターデーション値およびRthレターデーション値はいずれも3軸方向の屈折率で定義された値であるため、Re/Rth比はレターデーション発現に対する寄与が大きい添加剤によってほぼ決まってしまう。延伸倍率に対するRe/Rth比を調べた結果、その関係は比例関係にあり、延伸倍率が大きくなるとRe/Rth比は大きくなることが分かった。添加量を変えた場合も同様の比例関係となり、添加量を増やすとRe/Rth比は増加する。延伸倍率に対するRe/Rth比の傾きは添加素材によって決まり、上記特許文献1に具体的に記載されている円盤状化合物ではその傾きが小さいことが分かった

[0009]

レターデーション値を決めるセルローストリアセテートおよび添加剤の配向状態は延伸方法によっても異なる。一般に、一軸延伸する方法としてロール延伸法やテンター延伸法が知られているが、前者はフィルム幅の収縮が起こりn yが小さくなるため(n x - n y)値が大きくなりやすく、R e は発現しやすい。後者は搬送方向が規制されたまま幅方向に延伸されるため(n x - n y)値は大きくなりにくい。したがって、延伸倍率に対する R e / R t h比は前者に比べて後者は小さくなる。

テンター延伸法は膜厚や光学性能の面内ばらつきを小さくしやすいため、液晶表示装置用の光学補償シートを製造する手法として適している。この手法を前記開示の例に適用すると、Re/Rth比の増加量は延伸倍率1%当たり概ね0.01以下である。Re目標値とRth目標値が近く、Re/Rth比が0.5程度の場合、50%以上の延伸倍率が必要となる。延伸しにくいセルローストリアセテートフイルムにおいてこの倍率を安定的に実現することは事実上困難である。

また、添加量についても実際に可能な添加量の増量では目標光学性能を達成させることが困難であった。

【課題を解決するための手段】

[0010]

本発明者は、前述のような最適なRe、Rth値をテンター延伸法で実現するような場合、延伸倍率に対するRe/Rth増加量を大きくするために、上記特許文献1に記載されている円盤状化合物と、一般式(I)で表される化合物を併用して添加剤として用いることで延伸倍率に対するRe/Rth増加量を大きくすることができることを見出し、従来の手法では実現できなかった光学性能の光学補償シートを製造できることを見い出し、この知見に基づき本発明をなすに至った。

[0011]

【化1】

--般式(I)

$$R^{3}$$
 R^{4}
 R^{5}
 R^{10}
 R^{10}
 R^{9}
 R^{8}

[0012]

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^9 および R^{1} 0 はそれぞれ独立に水素原 子または置換基を表し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 および R^5 のうち少なくとも1つは電子供与性 基を表す。 R^8 は水素原子、炭素数 $1\sim4$ のアルキル基、炭素数 $2\sim6$ のアルケニル基、炭 素数 $2 \sim 6$ のアルキニル基、炭素数 $6 \sim 1$ 2 のアリール基、炭素数 $1 \sim 1$ 2 のアルコキシ 基、炭素数 $6 \sim 1$ 2 のアリールオキシ基、炭素数 $2 \sim 1$ 2 のアルコキシカルボニル基、炭 素数2~12のアシルアミノ基、シアノ基またはハロゲン原子を表す。)

[0013]

本発明の目的は、下記1~21の光学補償シート、下記22~24の偏光板および下記 25~28の液晶表示装置により達成される。

(1) セルロースアシレートと、該セルロースアシレート100質量部に対して下記一般 式(I)で表される化合物の少なくとも一種0.01乃至20質量部および該セルロース アシレート100質量部に対して少なくとも3つの置換基を有する環状化合物の少なくと も一種0.01乃至20質量部とを含むことを特徴とする光学補償シート。。

$[0\ 0\ 1\ 4\]$ 【化2】

一般式(I)

$$R^{3}$$
 R^{4}
 R^{5}
 R^{6}
 R^{7}

「式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^9 および R^{1} 0 はそれぞれ独立に水素原 子または置換基を表し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 および R^5 のうち少なくとも1つは電子供与性 基を表す。 R^8 は水素原子、炭素数 $1\sim4$ のアルキル基、炭素数 $2\sim6$ のアルケニル基、 炭素数 $2\sim6$ のアルキニル基、炭素数 $6\sim1$ 2 のアリール基、炭素数 $1\sim1$ 2 のアルコキ シ基、炭素数6~12のアリールオキシ基、炭素数2~12のアルコキシカルボニル基、 炭素数2~12のアシルアミノ基、シアノ基またはハロゲン原子を表す。)

- (2) Reレターデーション値が20乃至200nmであり、Rthレターデーション値が 70乃至400 n mであることを特徴とする(1)項に記載の光学補償シート。
- (3) Reレターデーション値が20乃至70nmであり、Rthレターデーション値が7 0乃至400nmであることを特徴とする(1)または(2)項に記載の光学補償シート
- (4) Reレターデーション値とRthレターデーション値との比(Re/Rth比)が 0. 1乃至0. 4 であることを特徴とする(1)~(3)のいずれか1項に記載の光学補 償シート。
- (5) 膜厚が $20\mu m\sim 160\mu m$ の一枚のセルロースアシレートフイルムのみからなる ことを特徴とする(1)~(4)のいずれか1項に記載の光学補償シート。

- (6) 700 n m でのR e レターデーション値 (R e 700) と400 n m でのR e レタ ーデーションの値(R e 4 0 0)の差(R e 7 0 0 - R e 4 0 0)が-2 5 nm乃至 1 0 nm であることを特徴とする(1)~(5)のいずれか1項に記載の光学補償シート。
- (7) 700 nmでのR t h レターデーション値(R t h 700) と400 nmでのR t h レターデーションの値(R t h 4 0 0)の差(R t h 7 0 0 - R t h 4 0 0)が-5 0 nm乃至 20 nmであることを特徴とする(1) \sim (6)のいずれか 1 項に記載の光学補償シ ート。
- (8) 25℃10% R H環境下で測定した R e レターデーション値、 R t h レターデーシ ョン値と25℃80%RH環境下で測定したReレターデーション値、Rthレターデー ション値の差異が、それぞれ25nm以内、70nm以内であることを特徴とする(1) ~ (7) のいずれか1項に記載の光学補償シート。
- (9) 25℃90%RHでの透湿度が20g/m²·24hr乃至250g/m²·24 hrであることを特徴とする(1) \sim (8)のいずれか1項に記載の光学補償シート。
- (10) 90℃Dryでの寸度変化が-0.15%以内であることを特徴とする(1)~
- (9) のいずれか1項に記載の光学補償シート。
- (11) 60℃90% R H での寸度変化が-0.15% 以内であることを特徴とする(1)~(10)のいずれか1項に記載の光学補償シート。
- (12)表面エネルギーが55乃至75mN/mであるセルロースアセテートフイルムか らなることを特徴とする(1)~(11)のいずれか1項に記載の光学補償シート。
- (13) 偏光板保護膜として使用した場合の60℃95%RH雰囲気下500時間経時後 の偏光度の低下が3%以内であることを特徴とする(1) \sim (12) のいずれか1項に記 載の光学補償シート。
- (14) 3乃至100%の延伸倍率で延伸したセルロースアシレートフイルムからなるこ とを特徴とする(1)~(13)のいずれか1項に記載の光学補償シート。
- (15) セルロースアシレートが、酢化度が59.0乃至61.5%であるセルロースア セテートであり、延伸倍率1%あたりのRe/Rth変化量が0.01乃至0.1である ことを特徴とする(1)~(14)のいずれか1項に記載の光学補償シート。
- (16) 長手方向に搬送しながら長手方向と直交する方向に延伸し、延伸開始時のセルロ ースアシレートフイルムの残留溶剤量が2%乃至50%の状態であり、該フィルムの遅相 軸が該フィルムの長尺方向に対して直交する方向にあることを特徴とする(1)~(15) のいずれか1項に記載の光学補償シート。
- (17) セルロースアシレートフィルムが、セルロースの水酸基がアセチル基および炭素 原子数が $3\sim2$ 2のアシル基で置換されたセルロースアシレートからなり、かつ該セルロ ースアシレートのアセチル基の置換度Aおよび炭素原子数が3~22のアシル基の置換度 Bが、下記式 (VI) および (VII) を満たすことを特徴とする $(1) \sim (16)$ のいずれ か1項に記載の光学補償シート。

式 (VI) : 2. $0 \le A + B \le 3$. 0

式 (VII) : 0 < B

- (18) 炭素原子数が3~22のアシル基が、ブタノイル基またはプロピオニル基である ことを特徴とする(17)項に記載の光学補償シート。
- (19) セルロースを構成するグルコース単位の水酸基を炭素原子数が2以上のアシル基 で置換して得られたセルロースアシレートからなるフィルムであって、セルロースを構成 するグルコース単位の 2 位の水酸基のアシル基による置換度を D S 2 、 3 位の水酸基のア シル基による置換度をDS3、6位の水酸基のアシル基による置換度をDS6としたとき に、下記式 (XII) および (XIII) を満たすセルロースアシレートフィルムであることを 特徴とする(1)~(18)のいずれか1項に記載の光学補償シート。

数式 (XII) : 2. 0 ≤ D S 2 + D S 3 + D S 6 ≤ 3. 0

数式 (XIII) : DS6/(DS2+DS3+DS6) ≥0.320

(20) アシル基がアセチル基であることを特徴とする(19) 項に記載の光学補償シー 卜。

(21)少なくとも3つの置換基を有する環状化合物が、一般式(II)で表される化合物 であることを特徴とする(1)項の光学補償シート。

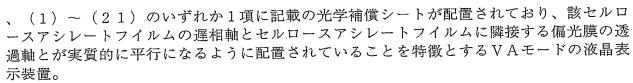
[0016]【化3】

一般式(II)

 $[0\ 0\ 1\ 7\]$

(式中、 X^1 は、単結合、 $-NR^4$ -、-O-または-S-をあらわし、; X^2 は、単結 合、 $-NR^5$ -、-O-または-S-をあらわし、; X^3 は、単結合、 $-NR^6$ -、-O-または-S-をあらわし、; R^1 、 R^2 および R^3 は、それぞれ独立に、アルキル基、 アルケニル基、アリール基または複素環基をあらわし;そして、 \mathbb{R}^4 、 \mathbb{R}^5 および \mathbb{R}^6 は 、それぞれ独立に、水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基または複素環基を あらわす。)

- (22) 偏光膜およびその両側に配置された二枚の透明保護膜からなる偏光板であって、 透明保護膜の少なくとも一方が、(1)~(21)のいずれか1項に記載の光学補償シー トであることを特徴とする偏光板。
- (23) 前記光学補償シートと反対側の透明保護膜には少なくとも光散乱層と低屈折率層 からなる鏡面反射率 2.5%以下の反射防止層を設けたことを特徴とする(22)項に記 載の偏光板。
- (24) 前記光学補償シートと反対側の透明保護膜には少なくとも中屈折率層、高屈折率 層、低屈折率層がこの順に積層されてなる鏡面反射率0.5%以下の反射防止層を設けた ことを特徴とする(22)または(23)項に記載の偏光板。
- (25)液晶セルおよびその両側に配置された二枚の偏光板からなり、該偏光板が偏光膜 およびその両側に配置された二枚の透明保護膜からなる液晶表示装置であって、該液晶セ ルと少なくとも一方の偏光板との間に、(1)~(21)のいずれか1項に記載の光学補 償シートが配置されており、該セルロースアシレートフイルムの遅相軸とセルロースアシ レートフイルムに隣接する偏光膜の透過軸とが実質的に平行になるように配置されている ことを特徴とする液晶表示装置。
- (26) 液晶セルおよびその両側に配置された二枚の偏光板からなり、該偏光板が偏光膜 およびその両側に配置された二枚の透明保護膜からなる液晶表示装置であって、該液晶セ ルと少なくとも一方の偏光板との間に、(1)~(21)のいずれか1項に記載の光学補 償シートが配置されており、該セルロースアシレートフイルムの遅相軸とセルロースアシ レートフイルムに隣接する偏光膜の透過軸とが実質的に平行になるように配置されている ことを特徴とするVAモードの液晶表示装置。
- (27) 液晶セルおよびその両側に配置された二枚の偏光板からなり、該偏光板が偏光膜 およびその両側に配置された二枚の透明保護膜からなる液晶表示装置であって、該液晶セ ルと観察者側、バックライト側それぞれの偏光板との間に、(1)~(21)のいずれか 1項に記載の光学補償シートが配置されており、該セルロースアシレートフイルムの遅相 軸とセルロースアシレートフイルムに隣接する偏光膜の透過軸とが実質的に平行になるよ うに配置されていることを特徴とするVAモードの液晶表示装置。
- (28) 液晶セルおよびその両側に配置された二枚の偏光板からなり、該偏光板が偏光膜 およびその両側に配置された二枚の透明保護膜からなる液晶表示装置であって、該液晶セ ルと観察者側、あるいは、該液晶セルとバックライト側のいずれか一方の偏光板との間に



【発明の効果】

[0018]

本発明の光学補償シートは、セルロースアセテートフイルムのみで液晶セルを光学的に 補償できる。

偏光板の保護膜は、一般にセルロースアセテートフイルムからなる。上記のセルロースアセテートフイルムを偏光板の一方の保護膜として用いると、偏光板の構成要素の数を増加することなく、偏光板に光学補償機能を追加することができる。

上記のセルロースアセテートフイルムのみからなる光学補償シートおよび上記のセルロースアセテートフイルムを保護膜として用いた偏光板は、VAモードおよびOCBモードの液晶表示装置に、特に有利に用いることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0019]

[フイルムのレターデーション]

本明細書において、Re(λ)、Rth(λ)は各々、波長 λ における面内のレターデーションおよび厚さ方向のレターデーションを表す。Re(λ)はKOBRA 21ADH(王子計測機器(株)製)において波長 λ nmの光をフィルム法線方向に入射させて測定される。Rth(λ)は前記Re(λ)、面内の遅相軸(KOBRA 21ADHにより判断される)を傾斜軸(回転軸)としてフィルム法線方向に対して+40°傾斜した方向から波長 λ nmの光を入射させて測定したレターデーション値、および面内の遅相軸を傾斜軸(回転軸)としてフィルム法線方向に対して-40°傾斜した方向から波長 λ nmの光を入射させて測定したレターデーション値の計3つの方向で測定したレターデーション値を基にKOBRA 21ADHが算出する。ここで平均屈折率の仮定値は、ポリマーハンドブック(JOHN WILEY&SONS, INC)、各種光学フィルムのカタログの値を使用することができる。セルロースアシレートの平均屈折率は1.48である。これら平均屈折率の仮定値と膜厚を入力することで、KOBRA 21ADHはnx、ny、nzを算出する。

[0020]

本発明では、好ましくは、セルロースアシレートフイルムのReレターデーション値を20万至200nmに、そしてRthレターデーション値を70万至400nmに調節する。また、本発明ではRe/Rth比を好ましくは、0.1万至0.8に調節する。さらに好ましくは、Reレターデーション値を20万至70nmに、Rthレターデーション値を90万至300nm、そしてRe/Rth比を0.25万至0.8に調節する。これらの調整は棒状化合物の種類、添加量および円盤状化合物の種類、添加量、および延伸倍率により行うことが出来る。

本発明においては、延伸倍率 1%あたりの Re/Rthの変化量を 0.01 乃至 0.1 とすることが可能である。ここで、延伸倍率 1% あたりの Re/Rth の変化量は、延伸倍率 5%以上の少なくとも 3 点の延伸倍率に対する Re/Rth 比を一次近似した時の傾きから求めることができる。

[0021]

[セルロースアシレートフイルム]

次に、本発明において用いられるセルロースアシレートについて詳細に記載する。本発 明においては異なる2種類以上のセルロースアシレートを混合して用いても良い。

前記のセルロースアシレートは、好ましくはセルロースの水酸基をアセチル基および炭 素原子数が3~22のアシル基で置換して得られたセルロースの混合脂肪酸エステルであ って、セルロースの水酸基への置換度が下記式(VI)及び(VII)を満足するセルロース アシレートである。

式 (VI) : 2. $0 \le A + B \le 3$. 0

式 (VII) : 0 < B

ここで、式中A及びBはセルロースの水酸基に置換されているアシル基の置換度を表し 、Aはアセチル基の置換度、またBは炭素原子数3~22のアシル基の置換度である。

セルロースを構成する $\beta-1$, 4結合しているグルコース単位は、2位、3位および6位に遊離の水酸基を有している。セルロースアシレートは、これらの水酸基の一部または 全部をアシル基によりエステル化した重合体(ポリマー)である。アシル置換度は、2位 、3位および6位のそれぞれについて、セルロースがエステル化している割合(100% のエステル化は置換度1)を意味する。

本発明では、水酸基のAとBとの置換度の総和(A+B)は、上記式(VI)に示すよう に、2.0~3.0であり、好ましくは2.2~2.9であり、特に好ましくは2.40 ~ 2 . 85である。また、Bの置換度は上記式(VII)に示すように、0より大きいこと が好ましく、0.6以上であることがさらに好ましい。

A+Bが2.0未満であると、親水性が強くなり環境湿度の影響を受けやすくなる。 さらにBはその28%以上が6位水酸基の置換基であるのが好ましいが、より好ましく は30%以上が6位水酸基の置換基であり、31%以上がさらに好ましく、特には32% 以上が6位水酸基の置換基であることが好ましい。

また更に、セルロースアシレートの6位のAとBの置換度の総和が0.75以上である のが好ましく、さらには0.80以上が、特には0.85以上が好ましい。これらのセル ロースアシレートフィルムにより溶解性、濾過性の好ましいフィルム調製用の溶液が作製 でき、非塩素系有機溶媒においても、良好な溶液の作製が可能となる。更に粘度が低くろ 過性のよい溶液の作成が可能となる。

[0022]

また、セルロースアシレートフィルムが偏光板の液晶セル側に配置される保護膜である 場合、セルロースを構成するグルコース単位の2位の水酸基のアシル基による置換度をD S2、3位の水酸基のアシル基による置換度をDS3、6位の水酸基のアシル基による置 換度をDS6としたときに、下記式 (XII) および (XIII) を満たすことが好ましい。

式 (XII) : 2. $0 \le DS2 + DS3 + DS6 \le 3$. 0

式 (XIII) : DS6/(DS2+DS3+DS6) \geq 0.315

上記式(XII)および(XIII)を満たすことにより、光学性能を好ましい範囲で調整す ることが容易となり、好ましい。

なお、DS2+DS3+DS6 をアセチル置換度、DS6/(DS2+DS3+DS6) を6位置換度 と呼ぶこともある。

[0023]

前記炭素原子数3以上のアシル基としては、脂肪族基でも芳香族炭化水素基でもよく特 に限定されない。それらは、例えばセルロースのアルキルカルボニルエステル、アルケニ ルカルボニルエステルあるいは芳香族カルボニルエステル、芳香族アルキルカルボニルエ ステルなどであり、それぞれさらに置換された基を有していてもよい。好ましい炭素原子 数3以上のアシル基としては、プロピオニル、ブタノイル、ケプタノイル、ヘキサノイル 、オクタノイル、デカノイル、ドデカノイル、トリデカノイル、テトラデカノイル、ヘキ サデカノイル、オクタデカノイル、iso-ブタノイル、t-ブタノイル、シクロヘキサ ンカルボニル、オレオイル、ベンゾイル、ナフチルカルボニル、シンナモイル基などを挙 げることが出来る。これらの中でも、好ましくはプロピオニル、ブタノイル、ドデカノイ

ル、オクタデカノイル、tーブタノイル、オレオイル、ベンゾイル、ナフチルカルボニル、シンナモイル基などである。特に好ましくはプロピオニル、ブタノイル基である。また、プロピオニル基の場合には置換度Bは1.3以上であるのが好ましい。

[0024]

前記混合脂肪酸セルロースアシレートとしては、具体的には、セルロースアセテートプロピオネート、セルロースアセテートブチレートが挙げられる。

[0025]

(セルロースアシレートの合成方法)

セルロースアシレートの合成方法の基本的な原理は、右田他、木材化学 180~190 頁 (共立出版、1968年) に記載されている。代表的な合成方法は、カルボン酸無水物 一酢酸ー硫酸触媒による液相酢化法である。

前記セルロースアシレートを得るには、具体的には、綿花リンタや木材パルプ等のセル ロース原料を適当量の酢酸で前処理した後、予め冷却したカルボン酸化混液に投入してエ ステル化し、完全セルロースアシレート(2位、3位および6位のアシル置換度の合計が 、ほぼ3.00)を合成する。上記カルボン酸化混液は、一般に溶媒としての酢酸、エス テル化剤としての無水カルボン酸および触媒としての硫酸を含む。無水カルボン酸は、こ れと反応するセルロースおよび系内に存在する水分の合計よりも、化学量論的に過剰量で 使用することが普通である。エステル化反応終了後に、系内に残存している過剰の無水カ ルボン酸の加水分解およびエステル化触媒の一部の中和のために、中和剤(例えば、カル シウム、マグネシウム、鉄、アルミニウムまたは亜鉛の炭酸塩、酢酸塩または酸化物)の 水溶液を添加する。次に、得られた完全セルロースアシレートを少量の酢化反応触媒(一 般には、残存する硫酸)の存在下で、50~90℃に保つことによりケン化熟成し、所望 のアシル置換度および重合度を有するセルロースアシレートまで変化させる。所望のセル ロースアシレートが得られた時点で、系内に残存している触媒を前記のような中和剤を用 いて完全に中和するか、あるいは中和することなく水または希硫酸中にセルロースアシレ ート溶液を投入(あるいは、セルロースアシレート溶液中に、水または希硫酸を投入)し てセルロースアシレートを分離し、洗浄および安定化処理を行う等して、前記の特定のセ ルロースアシレートを得ることができる。

[0026]

前記セルロースアシレートフィルムは、フィルムを構成するポリマー成分が実質的に上記の特定のセルロースアシレートからなることが好ましい。『実質的に』とは、ポリマー成分の55質量%以上(好ましくは70質量%以上、さらに好ましくは80質量%以上)を意味する。

前記セルロースアシレートは、粒子状で使用することが好ましい。使用する粒子の90 質量%以上は、 $0.5\sim5$ mmの粒子径を有することが好ましい。また、使用する粒子の50 質量%以上が $1\sim4$ mmの粒子径を有することが好ましい。セルロースアシレート粒子は、なるべく球形に近い形状を有することが好ましい。

本発明で好ましく用いられるセルロースアシレートの重合度は、粘度平均重合度で、好ましくは $200\sim700$ 、より好ましくは $250\sim550$ 、更に好ましくは $250\sim40$ 0であり、特に好ましくは $250\sim350$ である。平均重合度は、宇田らの極限粘度法(宇田和夫、斉藤秀夫、繊維学会誌、第18巻第1号、 $105\sim120$ 頁、1962年)により測定できる。更に特開平9-95538号公報に詳細に記載されている。

[0027]

低分子成分が除去されると、平均分子量(重合度)が高くなるが、粘度は通常のセルロースアシレートよりも低くなるため、前記セルロースアシレートとしては低分子成分を除去したものが有用である。低分子成分の少ないセルロースアシレートは、通常の方法で合成したセルロースアシレートから低分子成分を除去することにより得ることができる。低分子成分の除去は、セルロースアシレートを適当な有機溶媒で洗浄することにより実施できる。なお、低分子成分の少ないセルロースアシレートを製造する場合、酢化反応における硫酸触媒量を、セルロースアシレート100質量部に対して0.5~25質量部に調整

することが好ましい。硫酸触媒の量を上記範囲にすると、分子量分布の点でも好ましい(分子量分布の均一な)セルロースアシレートを合成することができる。セルロースアシレ ートの製造時に使用される際には、その含水率は2質量%以下であることが好ましく、さ らに好ましくは1質量%以下であり、特には0.7質量%以下である。一般に、セルロー スアシレートは、水を含有しており含水率2.5~5質量%が知られている。本発明でこ のセルロースアシレートの含水率にするためには、乾燥することが必要であり、その方法 は目的とする含水率になれば特に限定されない。

前記セルロースアシレートの原料綿や合成方法は、発明協会公開技報公技番号2001 -1745号(2001年3月15日発行、発明協会)p. 7-12に詳細に記載されて いる原料綿や合成方法を採用できる。

[0028]

本発明に関するセルロースアシレートフィルムは、前記の特定のセルロースアシレート と必要に応じて添加剤とを有機溶媒に溶解させた溶液を用いてフィルム化することにより 得ることができる。

[0029]

[レターデーション制御剤]

本発明では、一般式(I)で表される化合物と少なくとも3つの置換基を有する環状化 合物とを併用してセルロースエステルフイルムに添加する。少なくとも3つの置換基を有 する環状化合物、一般式(I)で示される化合物は共に、セルロースエステルフイルムの レターデーション上昇剤として機能できる。

ここで、少なくとも3つの置換基を有する環状化合物とは、少なくとも2つの芳香環を 有する芳香族化合物が好ましく、一般式 (II) で表される 1, 3, 5 - トリアジン環を有 する化合物を好ましく用いることができる。またはポルフィリン骨格を有する化合物を好 ましく用いることができる。特に特開2001-166144号公報に記載の化合物を用 いることが好ましい。

[0030]

以下に、一般式(1)で表される化合物に関して詳細に説明する。

一般式(1)

[0031]

【化4】

$$R^{3} \xrightarrow{R^{4}} R^{5} \qquad R^{10} \qquad R^{9}$$

[0032]

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^9 および R^{1} 0 はそれぞれ独立に水素 原子または置換基を表し、 \mathbb{R}^1 、 \mathbb{R}^2 、 \mathbb{R}^3 、 \mathbb{R}^4 および \mathbb{R}^5 のうち少なくとも1つは電子供与 性基を表す。 R 8 は水素原子、炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基、炭素数 $2\sim 6$ のアルキニル基 、炭素数 $6\sim1$ 2 のアリール基、炭素数 $1\sim1$ 2 のアルコキシ基、炭素数 $6\sim1$ 2 のアリ ールオキシ基、炭素数2~12のアルコキシカルボニル基、炭素数2~12のアシルアミ ノ基、シアノ基またはハロゲン原子を表す。)

[0033]

一般式(1)中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^9 および $R^{1\ 0}$ はそれぞれ独 立に水素原子、または置換基を表し、置換基は後述の置換基下が適用できる。

 \mathbb{R}^1 、 \mathbb{R}^2 、 \mathbb{R}^3 、 \mathbb{R}^4 および \mathbb{R}^5 のうち少なくとも1つは電子供与性基を表す。好ましくは \mathbb{R}^1 、 \mathbb{R}^3 または \mathbb{R}^5 のうちの1つが電子供与性基であり、 \mathbb{R}^3 が電子供与性基であることが より好ましい。

電子供与性基とはHammetの σ_p 値が0以下のものを表し、Chem. Rev. , 91, 165 (1991). 記載のHammetの σ_p 値が0以下のものが好ましく適用でき、より好ましくは $-0.85\sim0$ のものが用いられる。例えば、アルキル基、アルコキシ基、アミノ基、水酸基などが挙げられる。

電子供与性基として好ましくはアルキル基、アルコキシ基であり、より好ましくはアルコキシ基(好ましくは炭素数 $1\sim12$ 、より好ましくは炭素数 $1\sim8$ 、更に好ましくは炭素数 $1\sim6$ 特に好ましくは炭素数 $1\sim4$ である。)である。

[0034]

 R^1 として好ましくは、水素原子または電子供与性基であり、より好ましくはアルキル基、アルコキシ基、アミノ基、水酸基であり、更に好ましくは、炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基、炭素数 $1 \sim 1$ 2 のアルコキシ基であり、特に好ましくはアルコキシ基(好ましくは炭素数 $1 \sim 1$ 2、より好ましくは炭素数 $1 \sim 8$ 、更に好ましくは炭素数 $1 \sim 6$ 、特に好ましくは炭素数 $1 \sim 4$)であり、最も好ましくはメトキシ基である。

[0035]

 R^2 として好ましくは、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アミノ基、水酸基であり、より好ましくは、水素原子、アルキル基、アルコキシ基であり、更に好ましくは水素原子、アルキル基(好ましくは炭素数 $1\sim4$ 、より好ましくは炭素数 $1\sim8$ 、更に好ましくは炭素数 $1\sim6$ 、特に好ましくは炭素数 $1\sim4$)である。特に好ましくは水素原子、メチル基、メトキシ基である。

[0036]

 R^3 として好ましくは、水素原子または電子供与性基であり、より好ましくは水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アミノ基、水酸基であり、更に好ましくは、アルキル基、アルコキシ基であり、特に好ましくはアルコキシ基(好ましくは炭素数 $1\sim 12$ 、より好ましくは炭素数 $1\sim 8$ 、更に好ましくは炭素数 $1\sim 6$ 、特に好ましくは炭素数 $1\sim 4$)である。最も好ましくは $1\sim 1$ ロポキシ基、エトキシ基、メトキシ基である。

[0037]

 R^4 として好ましくは、水素原子または電子供与性基であり、より好ましくは水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アミノ基、水酸基であり、更に好ましくは、水素原子、炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基、炭素数 $1\sim 1$ 2 のアルコキシ基(好ましくは炭素数 $1\sim 1$ 2 のアルコキシ基(好ましくは炭素数 $1\sim 1$ 2 のアルコキシ基(好ましくは炭素数 $1\sim 4$ 0 アルコキシ基であり、特に好ましくは水素原子、炭素数 $1\sim 4$ 0 アルコキシ基であり、最も好ましくは水素原子、メチル基、メトキシ基である。

[0038]

 R^5 として好ましくは、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アミノ基、水酸基であり、より好ましくは、水素原子、アルキル基、アルコキシ基であり、更に好ましくは水素原子、アルキル基(好ましくは炭素数 $1\sim 4$ より好ましくはメチル基である。)、アルコキシ基(好ましくは炭素数 $1\sim 12$ 、より好ましくは炭素数 $1\sim 12$ 、メトキシ基である。

[0039]

 R^6 、 R^7 、 R^9 および R^{1} 0 として好ましくは水素原子、炭素数 $1\sim 1$ 2 のアルキル基、炭素数 $1\sim 1$ 2 のアルコキシ基、ハロゲン原子であり、より好ましくは、水素原子、ハロゲン原子(塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子など)であり、更に好ましくは水素原子である。

[0040]

 R^8 は水素原子、炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基、炭素数 $2\sim 6$ のアルキニル基、炭素数 $6\sim 1$ 2 のアリール基、炭素数 $1\sim 1$ 2 のアルコキシ基、炭素数 $1\sim 1$ 2 のアルコキシカルボニル基、炭素数 $1\sim 1$ 2 のアルコキシカルボニル基、炭素数 $1\sim 1$ 2 のアシルアミノ基、シア

ノ基またはハロゲン原子を表し、可能な場合には置換基を有してもよく、置換基としては 後述の置換基Tが適用できる。

 R^8 として好ましくは炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基、炭素数 $2\sim 6$ のアルキニル基、炭素 数 $6 \sim 1$ 2 のアリール基、炭素数 $1 \sim 1$ 2 のアルコキシ基、炭素数 $2 \sim 1$ 2 アリールオキ シ基であり、より好ましくは、炭素数6~12のアリール基、炭素数1~12のアルコキ シ基、炭素数 $6 \sim 1$ 2 のアリールオキシ基であり、更に好ましくは炭素数 $1 \sim 1$ 2 のアル コキシ基(好ましくは炭素数1~12、より好ましくは炭素数1~8、更に好ましくは炭 素数 $1\sim6$ 、特に好ましくは炭素数 $1\sim4$ である。)であり、特に好ましくは、メトキシ 基、エトキシ基、n-プロポキシ基、iso-プロポキシ基、n-ブトキシ基である。

[0041]

-般式(1)のうちより好ましくは下記一般式(1-A)である。

一般式 (1-A)

[0042]

【化5】

$$R^{11}O$$
 R^{4}
 R^{5}
 R^{6}
 R^{7}

[0043]

式中、 $R^{1\,1}$ はアルキル基を表す。 R^1 、 R^2 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^9 および $R^{1\ 0}$ は それぞれ独立に水素原子、または置換基を表す。 R 8 は水素原子、炭素数 $1 \sim 4$ のアルキ ル基、炭素数 $2\sim6$ のアルキニル基、炭素数 $6\sim1$ 2 のアリール基、炭素数 $1\sim1$ 2 のア ルコキシ基、炭素数6~12のアリールオキシ基、炭素数2~12のアルコキシカルボニ ル基、炭素数2~12のアシルアミノ基、シアノ基またはハロゲン原子を表す。)

一般式 (1-A) 中、 R^1 、 R^2 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 および R^{1} 0 はそれぞれ 一般式(1)におけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様である。

[0044]

一般式(1-A)中、 R^{11} は炭素数 $1\sim 1$ 2のアルキル基を表し、 R^{11} で表されるアルキル 基は直鎖でも分岐があってもよく、また更に置換基を有してもよいが、好ましくは炭素数 $1 \sim 12$ のアルキル基、より好ましくは炭素数 $1 \sim 8$ アルキル基、更に好ましくは炭素数 1~6アルキル基、特に好ましくは炭素数1~4のアルキル基(例えば、メチル基、エチル 基、nープロピル基、isoープロピル基、nーブチル基、isoーブチル基、tertーブチル基な どが挙げられる)を表す。

[0045]

一般式(1)のうちより好ましくは下記一般式(1-B)である。

一般式 (1-B)

[0046]

【化6】

$$R^{11}O$$
 R^{4}
 R^{5}
 R^{6}
 R^{7}

[0047]

「式中、 R^1 、 R^2 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^9 および R^{1} 0 はそれぞれ独立に水素原子、 または置換基を表す。 R^{1-1} は炭素数 $1\sim 1$ 2のアルキル基を表す。Xは炭素数 $1\sim 4$ のア ルキル基、炭素数 $2\sim6$ のアルキニル基、炭素数 $6\sim1$ 2 のアリール基、炭素数 $1\sim1$ 2のアルコキシ基、炭素数 6 ~ 1 2 のアリールオキシ基、炭素数 2 ~ 1 2 のアルコキシカル ボニル基、炭素数2~12のアシルアミノ基、シアノ基またはハロゲン原子を表す。)

[0048]

一般式(1-B)中、 R^1 、 R^2 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^9 、 R^{10} は一般式(1)にお けるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様である。

一般式 (1-B) 中、 \mathbb{R}^{1-1} は一般式 (1-A) におけるそれらと同義であり、また好ま しい範囲も同様である。

[0049]

一般式 (1-B) 中、Xは炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基、炭素数 $2\sim 6$ のアルキニル基、炭 素数 $6 \sim 1$ 2 のアリール基、炭素数 $1 \sim 1$ 2 のアルコキシ基、炭素数 $6 \sim 1$ 2 のアリール オキシ基、炭素数2~12のアルコキシカルボニル基、炭素数2~12のアシルアミノ基 、シアノ基またはハロゲン原子を表す。

 \mathbb{R}^1 、 \mathbb{R}^2 、 \mathbb{R}^4 、 \mathbb{R}^5 がすべて水素原子の場合にはXとして好ましくはアルキル基、アル キニル基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基であり、より好ましくは、アリ ール基、アルコキシ基、アリールオキシ基であり、更に好ましくはアルコキシ基(好まし くは炭素数 $1\sim1$ 2、より好ましくは炭素数 $1\sim8$ 、更に好ましくは炭素数 $1\sim6$ 、特に 好ましくは炭素数1~4である。)であり、特に好ましくは、メトキシ基、メトキシ基、 n-プロポキシ基、iso-プロポキシ基、n-ブトキシ基である。

[0050]

 \mathbb{R}^1 、 \mathbb{R}^2 、 \mathbb{R}^4 、 \mathbb{R}^5 のうち少なくとも1つが置換基の場合にはXとして好ましくはアルキ ニル基、アリール基、アルコキシカルボニル基、シアノ基、であり、より好ましくはアリ ール基(好ましくは炭素数6~12)、シアノ基、アルコキシカルボニル基(好ましくは 炭素数 $2\sim 1$ 2) であり、更に好ましくはアリール基(好ましくは炭素数 $6\sim 1$ 2のアリ ール基であり、より好ましくはフェニル基、p-シアノフェニル基、p-メトキシフェニ ルである。)、アルコキシカルボニル基(好ましくは炭素2~12、より好ましくは炭素 数2~6、更に好ましくは炭素数2~4、特に好ましくはメトキシカルボニル、エトキシ カルボニル、n-プロポキシカルボニルである。)、シアノ基であり、特に好ましくは、 フェニル基、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、n-プロポキシカルボニル基 、シアノ基である。

[0051]

-般式(1)のうち更に好ましくは下記一般式(1-C)である。

一般式 (1-C)

[0052]

【化7】

$$R^{11}O$$
 R^4
 R^5
 R^1
 R^2
 R^1
 R^2
 R^1
 R^2
 R^3
 R^5

[0053]

「式中、 R^1 、 R^2 、 R^4 、 R^5 、 R^{11} およびXは一般式(1-B)におけるそれらと同義で あり、また好ましい範囲も同様である。)

[0054]

一般式 (1) で表される化合物の中で好ましいのは下記一般式 (1-D) で表される化合物である。

一般式 (1-D)

[0055]

【化8】

$$R^{21}O$$
 R^{4}
 R^{5}
 R^{2}
 R^{22}
 $R^{21}O$
 R^{4}
 R^{5}

[0056]

(式中、 R^2 、 R^4 および R^5 は一般式(1-C)におけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様である。 R^{21} 、 R^{22} はそれぞれ独立に炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基である。 R^{21} は炭素数 R^{22} はそれぞれ独立に炭素数 R^{23} は炭素数 R^{23} は炭素数 R^{23} によっている。)

[0057]

 R^{21} は炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基を表し、好ましくは炭素数 $1 \sim 3$ のアルキル基であり、より好ましくはエチル基、メチル基である。

 R^{22} は炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基を表し、好ましくは炭素数 $1\sim 3$ のアルキル基であり、より好ましくはエチル基、メチル基であり、更に好ましくはメチル基である。

[0058]

 X^1 は炭素数 $6 \sim 1$ 2 のアリール基、炭素 $2 \sim 1$ 2 アルコキシカルボニル基、又はシアノ基であり、好ましくは炭素数 $6 \sim 1$ 0 のアリール基、炭素数 $2 \sim 6$ アルコキシカルボニル基、シアノ基であり、より好ましくはフェニル基、p-シアノフェニル基、p-メトキシフェニル基、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、n-プロポキシカルボニル、シアノ基であり、更に好ましくは、フェニル基、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、n-プロポキシカルボニル基、シアノ基である。

[0059]

一般式(1)のうち最も好ましくは下記一般式(1-E)である。

一般式 (1-E)

[0060]

【化9】

$$R^{21}O$$
 R^{2}
 R^{2}
 $R^{21}O$
 R^{4}
 R^{5}

[0061]

(式中、 R^2 、 R^4 および R^5 は一般式(1-D)におけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様だが、いずれか1つは $-0R^{13}$ で表される基である(R^{13} は炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基である。)。 R^{21} 、 R^{22} 、 X^1 は一般式(1-D)におけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様である。)

[0062]

一般式 (1-E) 中、 R^2 、 R^4 および R^5 は一般式 (1-D) におけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様だが、いずれか1つは $-0R^{13}$ で表される基であり(R^{13} は炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基である。)、好ましくは R^4 、 R^5 が $-0R^{13}$ で表される基であり、よ

り好ましくは R^4 が $-0R^{13}$ で表される基である。

 \mathbb{R}^{13} は炭素数 $1\sim4$ のアルキル基を表し、好ましくは炭素数 $1\sim3$ のアルキル基であり、より好ましくはエチル基、メチル基であり、更に好ましくはメチル基である。

[0063]

以下に前述の置換基Tについて説明する。

[0064]

置換基Tとしては例えばアルキル基(好ましくは炭素数 $1 \sim 2~0$ 、より好ましくは炭素数 $1 \sim 1~2$ 、特に好ましくは炭素数 $1 \sim 8$ であり、例えばメチル、 i~s~o~d プロピル、 i~s~o~d ロル、 i~s~o~d に i~s

[0065]

アルコキシ基(好ましくは炭素数 $1 \sim 20$ 、より好ましくは炭素数 $1 \sim 12$ 、特に好ましくは炭素数 $1 \sim 8$ であり、例えばメトキシ、ブトキシなどが挙げられる。)、アリールオキシ基(好ましくは炭素数 $6 \sim 20$ 、より好ましくは炭素数 $6 \sim 16$ 、特に好ましくは炭素数 $6 \sim 12$ であり、例えばフェニルオキシ、2 - t フチルオキシなどが挙げられる。)、アシル基(好ましくは炭素数 $1 \sim 20$ 、より好ましくは炭素数 $1 \sim 16$ 、特に好ましくは炭素数 $1 \sim 16$ 、例えばアセチル、ベンゾイル、ホルミル、ピバロイルなどが挙げられる。)、アルコキシカルボニル基(好ましくは炭素数 $1 \sim 16$ 、特に好ましくは炭素数 $1 \sim 16$ 、特に好ましくな炭素数 $1 \sim 16$ 、特に好ましくな炭素数 $1 \sim 16$ 、特に好きに対する $1 \sim 16$ $1 \sim 16$ 1

[0066]

[0067]

カルバモイル基(好ましくは炭素数 $1\sim 20$ 、より好ましくは炭素数 $1\sim 16$ 、特に好ましくは炭素数 $1\sim 12$ であり、例えばカルバモイル、メチルカルバモイル、ジエチルカルバモイル、フェニルカルバモイルなどが挙げられる。)、アルキルチオ基(好ましくは炭

素数 $1 \sim 20$ 、より好ましくは炭素数 $1 \sim 16$ 、特に好ましくは炭素数 $1 \sim 12$ であり、例えばメチルチオ、エチルチオなどが挙げられる。)、アリールチオ基(好ましくは炭素数 $6 \sim 20$ 、より好ましくは炭素数 $6 \sim 16$ 、特に好ましくは炭素数 $6 \sim 12$ であり、例えばフェニルチオなどが挙げられる。)、スルホニル基(好ましくは炭素数 $1 \sim 20$ 、より好ましくは炭素数 $1 \sim 16$ 、特に好ましくは炭素数 $1 \sim 12$ であり、例えばメシル、トシルなどが挙げられる。)、

[0068]

スルフィニル基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ま しくは炭素数1~12であり、例えばメタンスルフィニル、ベンゼンスルフィニルなどが 挙げられる。)、ウレイド基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~1 6、特に好ましくは炭素数 $1\sim1$ 2であり、例えばウレイド、メチルウレイド、フェニル ウレイドなどが挙げられる。)、リン酸アミド基(好ましくは炭素数1~20、より好ま しくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばジエチルリン酸ア ミド、フェニルリン酸アミドなどが挙げられる。)、ヒドロキシ基、メルカプト基、ハロ ゲン原子(例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、シアノ基、スルホ基 、カルボキシル基、ニトロ基、ヒドロキサム酸基、スルフィノ基、ヒドラジノ基、イミノ 基、ヘテロ環基(好ましくは炭素数1~30、より好ましくは1~12であり、ヘテロ原 子としては、例えば窒素原子、酸素原子、硫黄原子、具体的には例えばイミダゾリル、ピ リジル、キノリル、フリル、ピペリジル、モルホリノ、ベンゾオキサゾリル、ベンズイミ ダゾリル、ベンズチアゾリルなどが挙げられる。)、シリル基(好ましくは、炭素数3~ 40、より好ましくは炭素数3~30、特に好ましくは、炭素数3~24であり、例えば トリメチルシリル、トリフェニルシリルなどが挙げられる)などが挙げられる。これら の置換基は更に置換されてもよい。

[0069]

また、置換基が二つ以上ある場合は、同じでも異なってもよい。また、可能な場合には 互いに連結して環を形成してもよい。

[0070]

以下に一般式(1)で表される化合物に関して具体例をあげて詳細に説明するが、本発明は以下の具体例によって何ら限定されることはない。

[0071]

【化10】

A-1 H₃CO H₃CO OCH3 O A-2 H₃CO A-3 A-4 A-5 H₃CO A-6 Λ-7 **A-**8 OCH₃ A-9

【0072】 【化11】

A-16
$$H_3CO \xrightarrow{OCH_3} C - O \xrightarrow{II} OCH_3$$

$$H_3CO \xrightarrow{II} C - O \xrightarrow{II} OCH_3$$

A-17
$$OCH_3$$
 OCH_3 OCH_3

[0073]

【化12】

A-18

$$H_{3}CO$$
 CH_{3}
 CO
 CH_{3}
 CO
 CCH_{3}
 CO
 CCH_{3}
 $CCCH_{3}$
 CCH_{3}
 $CCCH_{3}$
 CCH_{3}
 CCH_{3}

[0074]

【化13】

A-35
$$C_2H_5O$$
 C_2H_5O C_2H_5O

A-36
$$C_3H_7O$$
 C_3H_7O C_7O C_7O C_7O C_7O

[0075]

【化14】

A-42
$$0 \in \mathbb{H}_3$$
 $0 \in \mathbb{H}_3$ $0 \in \mathbb{H}_3$

【化15】

[0077]

本発明一般式(1)で表される化合物は置換安息香酸とフェノール誘導体の一般的なエステル反応によって合成でき、エステル結合形成反応であればどのような反応を用いてもよい。例えば、置換安息香酸を酸ハロゲン化物に官能基変換した後、フェノールと縮合する方法、縮合剤あるいは触媒を用いて置換安息香酸とフェノール誘導体を脱水縮合する方法などがあげられる。

製造プロセス等を考慮すると置換安息香酸を酸ハロゲン化物に官能基変換した後、フェ ノールと縮合する方法が好ましい。

[0078]

反応溶媒として炭化水素系溶媒(好ましくはトルエン、キシレンが挙げられる。)、エーテル系溶媒(好ましくはジメチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンなどが挙げられる)、ケトン系溶媒、エステル系溶媒、アセトニトリル、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドなどを用いることができる。これらの溶媒は単独でも数種を混合して用いてもよく、反応溶媒として好ましくはトルエン、アセトニトリル、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドである。

[0079]

反応温度としては、好ましくは $0\sim150$ C、より好ましくは $0\sim100$ C、更に好ましくは $0\sim90$ Cであり、特に好ましくは20 C ~90 C である。

本反応には塩基を用いないのが好ましく、塩基を用いる場合には有機塩基、無機塩基の どちらでもよく、好ましくは有機塩基であり、ピリジン、3級アルキルアミン(好ましく はトリエチルアミン、エチルジイソプルピルアミンなどが挙げられる)である。

[0800]

一般式 (I) で示される化合物および、少なくとも3つの置換基を有する環状化合物はそれぞれ、セルロースアセテート100質量部に対して、0.01乃至20質量部の範囲で使用する。一般式 (I) で示される化合物および、少なくとも3つの置換基を有する環

状化合物は、セルロースアセテート100質量部に対して、0.05乃至15質量部の範囲で使用することが好ましく、0.1乃至10質量部の範囲で使用することがさらに好ましい。一般式(I)で示される化合物および、少なくとも3つの置換基を有する環状化合物はそれぞれ、2種以上の化合物を併用しても良い。

[0081]

特開 2001-166144 号公報に明記されているように、一般に円盤状化合物は、棒状化合物よりもレターデーション上昇効果が優れており、比較的少量の使用量でもセルロースエステルフイルムのレターデーションを上昇させることができる。しかし、Reレターデーション値のみでなくRthレターデーション値も上昇してしまうため、円盤状化合物のみを用いて、本発明の目的である、高Reレターデーション値を持ち、低Rthレターデーション値を持つセルロースエステルフイルムを作製することは困難であった。

また、棒状化合物を使用すると、Re/Rth比の大きいセルロースアセテートフイルムを作製することができるが、棒状化合物のみを用いて本発明の目的である高 $Re\nu$ 9ーデーション値を達成するには、棒状化合物を多量に添加する必要がある。添加量が増えるとコスト的に不利になるばかりでなく、セルロースエステルフイルムの表面に析出(ブリードアウト)が生じやすくなり、製造適性上好ましくない。そのため、棒状化合物のみを用いて本発明の目的である光学性能を有したセルロースエステルフイルムを作製することも困難であった。

[0082]

本発明者が鋭意研究した結果、円盤状化合物と棒状化合物(一般式(I)で示される化合物)を併用して添加することで、単純な足し合わせ効果のみでなく、予想以上の好ましい光学性能(高Re レターデーション値、低Rt h レターデーション値)を達成できることがわかった。

[0083]

[セルロースアセテートフイルムの製造]

ソルベントキャスト法によりセルロースアシレートフイルムを製造することが好ましい。ソルベントキャスト法では、セルロースアシレートを有機溶媒に溶解した溶液 (ドープ) を用いてフイルムを製造する。

有機溶媒は、炭素原子数が3乃至12のエーテル、炭素原子数が3乃至12のケトン、 炭素原子数が3乃至12のエステルおよび炭素原子数が1乃至6のハロゲン化炭化水素か ら選ばれる溶媒を含むことが好ましい。

エーテル、ケトンおよびエステルは、環状構造を有していてもよい。エーテル、ケトンおよびエステルの官能基(すなわち、-〇-、-C〇-および-C〇〇-)のいずれかを二つ以上有する化合物も、有機溶媒として用いることができる。有機溶媒は、アルコール性水酸基のような他の官能基を有していてもよい。二種類以上の官能基を有する有機溶媒の場合、その炭素原子数は、いずれかの官能基を有する化合物の規定範囲内であればよい

[0084]

炭素原子数が 3 乃至 1 2 のエーテル類の例には、ジイソプロピルエーテル、ジメトキシメタン、ジメトキシエタン、1, 4 ージオキサン、1, 3 ージオキソラン、テトラヒドロフラン、アニソールおよびフェネトールが含まれる。

炭素原子数が3乃至12のケトン類の例には、アセトン、メチルエチルケトン、ジエチルケトン、ジイソブチルケトン、シクロヘキサノンおよびメチルシクロヘキサノンが含まれる。

炭素原子数が3万至12のエステル類の例には、エチルホルメート、プロピルホルメート、ペンチルホルメート、メチルアセテート、エチルアセテートおよびペンチルアセテートが含まれる。

二種類以上の官能基を有する有機溶媒の例には、2-エトキシエチルアセテート、2-メトキシエタノールおよび2-ブトキシエタノールが含まれる。

ハロゲン化炭化水素の炭素原子数は、1または2であることが好ましく、1であること

が最も好ましい。ハロゲン化炭化水素のハロゲンは、塩素であることが好ましい。ハロゲ ン化炭化水素の水素原子が、ハロゲンに置換されている割合は、25乃至75モル%であ ることが好ましく、30乃至70モル%であることがより好ましく、35乃至65モル% であることがさらに好ましく、40乃至60モル%であることが最も好ましい。メチレン クロリドが、代表的なハロゲン化炭化水素である。

二種類以上の有機溶媒を混合して用いてもよい。

[0085]

一般的な方法でセルロースアシレート溶液を調製できる。一般的な方法とは、0℃以上 の温度(常温または高温)で、処理することを意味する。溶液の調製は、通常のソルベン トキャスト法におけるドープの調製方法および装置を用いて実施することができる。なお 、一般的な方法の場合は、有機溶媒としてハロゲン化炭化水素(特にメチレンクロリド) を用いることが好ましい。

セルロースアシレートの量は、得られる溶液中に10乃至40質量%含まれるように調 整する。セルロースアシレートの量は、10乃至30質量%であることがさらに好ましい 。有機溶媒(主溶媒)中には、後述する任意の添加剤を添加しておいてもよい。

溶液は、常温 (0乃至40℃) でセルロースアシレートと有機溶媒とを攪拌することに より調製することができる。高濃度の溶液は、加圧および加熱条件下で攪拌してもよい。 具体的には、セルロースアシレートと有機溶媒とを加圧容器に入れて密閉し、加圧下で溶 媒の常温における沸点以上、かつ溶媒が沸騰しない範囲の温度に加熱しながら攪拌する。 加熱温度は、通常は40℃以上であり、好ましくは60乃至200℃であり、さらに好ま しくは80乃至110℃である。

[0086]

各成分は予め粗混合してから容器に入れてもよい。また、順次容器に投入してもよい。 容器は攪拌できるように構成されている必要がある。窒素ガス等の不活性気体を注入して 容器を加圧することができる。また、加熱による溶媒の蒸気圧の上昇を利用してもよい。 あるいは、容器を密閉後、各成分を圧力下で添加してもよい。

加熱する場合、容器の外部より加熱することが好ましい。例えば、ジャケットタイプの 加熱装置を用いることができる。また、容器の外部にプレートヒーターを設け、配管して 液体を循環させることにより容器全体を加熱することもできる。

容器内部に攪拌翼を設けて、これを用いて攪拌することが好ましい。攪拌翼は、容器の 壁付近に達する長さのものが好ましい。攪拌翼の末端には、容器の壁の液膜を更新するた め、掻取翼を設けることが好ましい。

容器には、圧力計、温度計等の計器類を設置してもよい。容器内で各成分を溶剤中に溶 解する。調製したドープは冷却後容器から取り出すか、あるいは、取り出した後、熱交換 器等を用いて冷却する。

[0087]

冷却溶解法により、溶液を調製することもできる。冷却溶解法では、通常の溶解方法で は溶解させることが困難な有機溶媒中にもセルロースアセテートを溶解させることができ る。なお、通常の溶解方法でセルロースアセテートを溶解できる溶媒であっても、冷却溶 解法によると迅速に均一な溶液が得られるとの効果がある。

冷却溶解法では最初に、室温で有機溶媒中にセルロースアセテートを撹拌しながら徐々 に添加する。

セルロースアシレートの量は、この混合物中に10乃至40質量%含まれるように調整 することが好ましい。セルロースアシレートの量は、10乃至30質量%であることがさ らに好ましい。さらに、混合物中には後述する任意の添加剤を添加しておいてもよい。

[0088]

次に、混合物を-100乃至-10 \mathbb{C} (好ましくは-80乃至-10 \mathbb{C} 、さらに好まし くは−50乃至−20℃、最も好ましくは−50乃至−30℃)に冷却する。冷却は、例 えば、ドライアイス・メタノール浴(−75℃)や冷却したジエチレングリコール溶液(-30乃至-20℃)中で実施できる。このように冷却すると、セルロースアシレートと

有機溶媒の混合物は固化する。

冷却速度は、4 $\mathbb{C}/$ 分以上であることが好ましく、8 $\mathbb{C}/$ 分以上であることがさらに好 ましく、12℃/分以上であることが最も好ましい。冷却速度は、速いほど好ましいが、 10000 \mathbb{C} extstyle extst100℃/秒が実用的な上限である。なお、冷却速度は、冷却を開始する時の温度と最終 的な冷却温度との差を冷却を開始してから最終的な冷却温度に達するまでの時間で割った 値である。

さらに、これを0乃至200℃(好ましくは0乃至150℃、さらに好ましくは0乃至 120℃、最も好ましくは0乃至50℃)に加温すると、有機溶媒中にセルロースアセテ ートが溶解する。昇温は、室温中に放置するだけでもよいし、温浴中で加温してもよい。 加温速度は、4 $\mathbb{C}/$ 分以上であることが好ましく、8 $\mathbb{C}/$ 分以上であることがさらに好 ましく、12℃/分以上であることが最も好ましい。加温速度は、速いほど好ましいが、 10000℃/秒が理論的な上限であり、<math>1000℃/秒が技術的な上限であり、そして100℃/秒が実用的な上限である。なお、加温速度は、加温を開始する時の温度と最終 的な加温温度との差を加温を開始してから最終的な加温温度に達するまでの時間で割った 値である。

以上のようにして、均一な溶液が得られる。なお、溶解が不充分である場合は冷却、加 温の操作を繰り返してもよい。溶解が充分であるかどうかは、目視により溶液の外観を観 察するだけで判断することができる。

冷却溶解法においては、冷却時の結露による水分混入を避けるため、密閉容器を用いる ことが望ましい。また、冷却加温操作において、冷却時に加圧し、加温時の減圧すると、 溶解時間を短縮することができる。加圧および減圧を実施するためには、耐圧性容器を用 いることが望ましい。

なお、セルロースアシレート(酢化度:60.9%、粘度平均重合度:299)を冷却 溶解法によりメチルアセテート中に溶解した20質量%の溶液は、示差走査熱量測定(D SC)によると、33℃近傍にゾル状態とゲル状態との疑似相転移点が存在し、この温度 以下では均一なゲル状態となる。従って、この溶液は疑似相転移温度以上、好ましくはゲ ル相転移温度プラス10℃程度の温度で保存する必要がある。ただし、この疑似相転移温 度は、セルロースアシレートの酢化度、粘度平均重合度、溶液濃度や使用する有機溶媒に

なお、酢化度とは、セルロース単位重量当たりの結合酢酸量を意味する。酢化度は、A より異なる。 STM:D-817-91 (セルロースアセテート等の試験法) におけるアセチル化度の 測定および計算に従う。

調製したセルロースアシレート溶液(ドープ)から、ソルベントキャスト法によりセル ロースアシレテートフイルムを製造する。

ドープは、ドラムまたはバンド上に流延し、溶媒を蒸発させてフイルムを形成する。流 延前のドープは、固形分量が18乃至35%となるように濃度を調整することが好ましい 。ドラムまたはバンドの表面は、鏡面状態に仕上げておくことが好ましい。ソルベントキ ャスト法における流延および乾燥方法については、米国特許2336310号、同236 7603号、同2492078号、同2492977号、同2492978号、同260 7704号、同2739069号、同2739070号、英国特許640731号、同7 36892号の各明細書、特公昭45-4554号、同49-5614号、特開昭60-176834号、同60-203430号、同62-115035号の各公報に記載があ

ドープは、表面温度が10℃以下のドラムまたはバンド上に流延することが好ましい。 流延してから2秒以上風に当てて乾燥することが好ましい。得られたフイルムをドラムま たはバンドから剥ぎ取り、さらに100から160℃まで逐次温度を変えた高温風で乾燥 して残留溶剤を蒸発させることもできる。以上の方法は、特公平5-17844号公報に 記載がある。この方法によると、流延から剥ぎ取りまでの時間を短縮することが可能であ る。この方法を実施するためには、流延時のドラムまたはバンドの表面温度においてドー プがゲル化することが必要である。

[0093]

セルロースアシレートフイルムには、機械的物性を改良するため、または乾燥速度を向 上するために、可塑剤を添加することができる。可塑剤としては、リン酸エステルまたは カルボン酸エステルが用いられる。リン酸エステルの例には、トリフェニルフォスフェー ト (TPP) およびトリクレジルホスフェート (TCP) が含まれる。

[0094]

カルボン酸エステルとしては、フタル酸エステルおよびクエン酸エステルが代表的であ る。フタル酸エステルの例には、ジメチルフタレート(DMP)、ジエチルフタレート(DEP)、ジブチルフタレート(DBP)、ジオクチルフタレート(DOP)、ジフェニ ルフタレート(DPP) およびジエチルヘキシルフタレート(DEHP) が含まれる。ク エン酸エステルの例には、〇一アセチルクエン酸トリエチル(〇ACTE)および〇一ア セチルクエン酸トリブチル(OACTB)が含まれる。その他のカルボン酸エステルの例 には、オレイン酸ブチル、リシノール酸メチルアセチル、セバシン酸ジブチル、種々のト リメリット酸エステルが含まれる。フタル酸エステル系可塑剤(DMP、DEP、DBP 、DOP、DPP、DEHP)が好ましく用いられる。DEPおよびDPPが特に好まし V20

可塑剤の添加量は、セルロースエステルの量の0.1乃至25質量%であることが好ま しく、1乃至20質量%であることがさらに好ましく、3乃至15質量%であることが最 も好ましい。

[0095]

セルロースアセテートフイルムには、劣化防止剤(例、酸化防止剤、過酸化物分解剤、 ラジカル禁止剤、金属不活性化剤、酸捕獲剤、アミン)を添加してもよい。劣化防止剤に ついては、特開平3-199201号、同5-1907073号、同5-194789号 、同5-271471号、同6-107854号の各公報に記載がある。劣化防止剤の添 加量は、劣化防止剤添加による効果が発現し、フィルム表面への劣化防止剤のブリードア ウト (滲み出し)を抑制する観点から、調製する溶液 (ドープ) の 0. 0 1 乃至 1 質量% であることが好ましく、0.01乃至0.2質量%であることがさらに好ましい。特に好 ましい劣化防止剤の例としては、ブチル化ヒドロキシトルエン(BHT)、トリベンジル アミン(TBA)を挙げることができる。

[0096]

[セルロースアシレートフイルムの延伸処理]

セルロースアセテートフイルムは、延伸処理によりレターデーションを調整することが できる。延伸倍率は、3乃至100%であることが好ましい。

延伸方法は請求の範囲を逸脱しない範囲で既存の方法を用いることができるが、面内の 均一性の観点から特にテンター延伸が好ましく用いられる。本発明のセルロースアシレー トフイルムは少なくとも100cm以上の幅であることが好ましく、全幅のRe値のばら つきが±5 nmであることが好ましく、±3 nmであることが更に好ましい。また、Rt h値のバラツキは±10nmが好ましく、±5nmであることが更に好ましい。また、長 さ方向のRe値、及びRth値のバラツキも幅方向のバラツキの範囲内であることが好ま しい。

[0097]

また延伸処理は製膜工程の途中で行ってもよいし、製膜して巻き取った原反を延伸処理 しても良い。前者の場合には残留溶剤量を含んだ状態で延伸を行っても良く、延伸開始時 の残留溶剤量が2乃至50%であることが好ましい。延伸開始時の残留溶剤量とは、テン ター延伸であれば、ウェブ(生乾きのドープ)の両端をクリップで掴み始めた時の残留溶 剤量のことであり、5乃至50%で延伸を開始することがさらに好ましく、10乃至45 %で延伸を開始することが特に好ましい。なお、残留溶剤量は下記式で計算する。

(残留溶剤量)=

100× | (ウェブ中の溶剤量) / (ウェブの全体量) |

また、この際、フィルムを長手方向に搬送しながら長手方向と直交する方向に延伸して 該フィルムの遅相軸が該フィルムの長尺方向に対して直交するようにすることが好ましい

延伸温度は延伸時の残留溶剤量と膜厚によって適当な条件を選ぶことができる。

[0098]

残留溶剤を含む状態で延伸した場合には、延伸後に乾燥させることが好ましい。乾燥方 法は前記フィルムの製膜に記載の方法に準じて行うことができる。

延伸後のセルロースアセテートフイルムの厚さは、好ましくは20乃至160 µ mであ り、より好ましくは60乃至110μmであり、80乃至110μmであることが最も好 ましい。この膜厚は本発明の光学補償シートの膜厚に相当する。

[0099]

[セルロースアシレートフイルムの波長分散]

光学補償シートに必要な性能として、Reレターデーション値、Rthレターデーショ ン値の波長分散形状が挙げられる。光学補償シートはネガティブリターダーとして働き、 ポジティブリターダーである液晶を補償するため、可視光の全波長域で偏光を補償するに は、光学補償シートのRthレターデーション値波長分散形状が液晶の波長分散形状と類 似していることが必要である。現在、液晶セルに封入している液晶の波長分散形状はほと んどが順分散であることが知られているので、光学補償シートのReレターデーション値 、Rthレターデーション値波長分散形状も、順分散形状であること、すなわち、700 nmでのReレターデーション値(Re700)と400nmでのReレターデーション 値(Re400)の差(Re700-Re400)が-25 nm乃至10 nmであること が好ましく、一25nm乃至5nmであることがさらに好ましい。また、700nmでの Rthレターデーション値(Rth700)と400nmでのRthレターデーションの 値 (Rth400) の差 (Rth700-Rth400) が-50nm乃至20nmであるこ とが好ましく、さらにはRth700-Rth400が-50nm乃至10nmであるこ とが特に好ましい。

[0100]

Re700-Re400及びRth700-Rth400は、作製したセルロースアセ テートフイルムについて、エリプソメーター(M-150、日本分光(株)製)を用いて 、波長700nmおよび波長400nmにおけるRthレターデーション値を測定し求めた

$[0\ 1\ 0\ 1]$

[Reレターデーション値、Rthレターデーション値の湿度依存性]

Reレターデーション値、Rthレターデーション値は、環境湿度による変化が小さい ことが望まれる。

25℃10% R H環境下で測定した R e レターデーション値、 R t h レターデーション 値と25℃80%RH環境下で測定したReレターデーション値の差異(Re10%-R e 8 0 % (2 5 ℃))、R t h レターデーション値の差異(R t h 1 0 % - R t h 8 0 % (25℃)) も小さいことが好ましく、それぞれ25 n m以内、70 n m以内であること が好ましい。また、さらにはRelO%-Re8O% (25℃) が15nm以内、Rth 10%-Rth80%(25℃)が50nm以内であることが好ましく、特には、Re1 0%-Re80% (25℃) が10nm以内、Rth10%-Rth80% (25℃) が 40 n m以内であることが好ましい。

[0102]

「透湿度」

透湿度は、例えば試料70mmΦを25℃90%RHで24時間調湿し、透湿試験装置 出証特2005-3029028

(KK-709007、東洋精機(株))にてJIS Z-0208に従って、単位面積 あたりの水分量を算出(g/m^2)し、

透湿度=調湿後重量-調湿前重量

で求めることができる。

25℃90%RHでの透湿度は20g/m²·24hr乃至250g/m²·24hr であることが好ましく、さらには20g/m²·24hr乃至230g/m²·24hr であることが特に好ましい。

[0103]

「寸度変化率」

寸法変化率は例えば、以下のように求めることができる。試料の縦方向、横方向より、 30mm幅×120mm長さの試験片を各3枚採取する。試験片の両端に6mmΦの穴を パンチで100mm間隔に開ける。これを23±3℃、相対湿度65±5%の室内で2時 間以上調湿する。自動ピンゲージ(新東科学(株)製)を用いてパンチ間隔の原寸(L1)を最小目盛り/1000mmまで測定する。次に試験片を90℃±1℃の恒温器に吊し て24時間熱処理し、23±3℃、相対湿度65±5%の室内で2時間以上調湿した後、 自動ピンゲージで熱処理後のパンチ間隔の寸法(L2)を測定する。そして以下の式によ り寸度変化を算出する。

寸度変化率= (L2-L1/L1) ×100

[0104]

[高湿寸度変化率]

高湿寸度変化率例えば、以下のように求めることができる。試料の縦方向、横方向より 、30mm幅×120mm長さの試験片を各3枚採取する。試験片の両端に6mmΦの穴 をパンチで100mm間隔に開ける。これを23±3℃、相対湿度65±5%の室内で2 時間以上調湿する。自動ピンゲージ(新東科学(株)製)を用いてパンチ間隔の原寸(L 1) を最小目盛り/1000mmまで測定する。次に試験片を60℃±1℃、相対湿度9 0±5%の恒温恒湿器に吊して24時間熱処理し、23±3℃、相対湿度65±5%の室 内で2時間以上調湿した後、自動ピンゲージで熱処理後のパンチ間隔の寸法(L3)を測 定する。そして以下の式により寸度変化を算出する。

寸度変化率= (L3-L1/L1) ×100

90℃Dry、60℃90%での寸度変化はともに小さいことが望まれ、それぞれ-0 . 2%以内であることが好ましく、さらには-0.15%以内であることが好ましい。

[0105]

[セルロースアセテートフイルムの表面処理]

セルロースアセテートフイルムの表面エネルギーを55万至75mN/mとすることが 好ましく、そのためには、表面処理を施すことが好ましい。表面処理の例として、ケン化 処理、プラズマ処理、火炎処理、および紫外線照射処理が挙げられる。ケン化処理には、 酸ケン化処理およびアルカリケン化処理が含まれる。プラズマ処理にはコロナ放電処理お よびグロー放電処理が含まれる。フィルムの平面性を保つために、これらの表面処理にお いては、セルロースアセテートフイルムの温度をガラス転移温度(Tg)以下、具体的に は150℃以下とすることが好ましい。これらの表面処理後のセルロースアセテートフイ ルムの表面エネルギーは55万至75mN/mであることが好ましくい。

グロー放電処理は、 $10^{-3}\sim 20 \mathrm{Torr}$ の低圧ガス下でおこる低温プラズマでもよ く、更にまた大気圧下でのプラズマ処理も好ましい。プラズマ励起性気体は、上記のよう な条件においてプラズマ励起される気体であり、アルゴン、ヘリウム、ネオン、クリプト ン、キセノン、窒素、二酸化炭素、テトラフルオロメタンの様なフロン類及びそれらの混 合物などがあげられる。これらについては、詳細が発明協会公開技報(公技番号 200 1-1745、2001年3月15日発行、発明協会)にて30頁~32頁に詳細に記載 されている。なお、近年注目されている大気圧でのプラズマ処理は、例えば $10\sim100$ 0 k e V下で20~500 k G y の照射エネルギーが用いられ、より好ましくは30~5 00keV下で20~300kGyの照射エネルギーが用いられる。これらの中でも特に 好ましくは、アルカリ鹸化処理でありセルロースアシレートフィルムの表面処理としては 極めて有効である。

[0106]

アルカリ鹸化処理は、セルロースアシレートフィルムを鹸化液の槽に直接浸漬する方法 または鹸化液をセルロースアシレートフィルム塗布する方法で実施することが好ましい。 塗布方法としては、ディップコーティング法、カーテンコーティング法、エクストルージ ョンコーティング法、バーコーティング法およびE型塗布法を挙げることができる。アル カリ鹸化処理塗布液の溶媒は、鹸化液の透明支持体に対して塗布するために濡れ性が良く 、また鹸化液溶媒によって透明支持体表面に凹凸を形成させずに、面状を良好なまま保つ 溶媒を選択することが好ましい。具体的には、アルコール系溶媒が好ましく、イソプロピ ルアルコールが特に好ましい。また、界面活性剤の水溶液を溶媒として使用することもで きる。アルカリ鹸化塗布液のアルカリは、上記溶媒に溶解するアルカリが好ましく、KO H、NaOHがさらに好ましい。鹸化塗布液のpHは10以上が好ましく、12以上がさ らに好ましい。アルカリ鹸化時の反応条件は、室温で1秒以上5分以下が好ましく、5秒 以上5分以下がさらに好ましく、20秒以上3分以下が特に好ましい。アルカリ鹸化反応 後、鹸化液塗布面を水洗あるいは酸で洗浄したあと水洗することが好ましい。

[0107]

これらの方法で得られた固体の表面エネルギーは「ぬれの基礎と応用」(リアライズ社 1989.12.10発行)に記載のように接触角法、湿潤熱法、および吸着法により 求めることができる。本発明のセルロースアセテートフイルムの場合、接触角法を用いる ことが好ましい。具体的には、表面エネルギーが既知である2種類の溶液をセルロースア セテートフイルムに滴下し、液滴の表面とフィルム表面との交点において、液滴に引いた 接線とフィルム表面のなす角で、液滴を含む方の角を接触角と定義し、計算によりフィル ムの表面エネルギーを算出できる。

[0108]

セルロースアセテートフイルムに上記の表面処理を実施することにより、フィルムの表 面エネルギーが55乃至75mN/mであるセルロースアセテートフイルムを得ることが できる。このセルロースアセテートフイルムを偏光板の透明保護膜とすることにより、偏 光膜とセルロースアセテートフイルムの接着性を向上させることができる。また、本発明 のセルロースアセテートフイルムをOCBモードの液晶表示装置に用いる場合、本発明の 光学補償シートは、セルロースアセテートフイルム上に配向膜を形成し、その上に円盤状 化合物もしくは棒状液晶化合物を含む光学異方性層を設けても良い。光学異方性層は、配 向膜上に円盤状化合物(もしくは棒状液晶化合物)を配向させ、その配向状態を固定する ことにより形成する。このようにセルロースアセテートフイルム上に光学異方性層を設け る場合、従来ではセルロースアセテートフイルムと配向膜との接着性を確保するために、 両者の間にゼラチン下塗り層を設ける必要があったが、本発明の、表面エネルギーが55 乃至75mN/mであるセルロースアセテートフイルムを用いることにより、ゼラチン下 塗り層を不要とすることができる。

[0109]

以上説明した、少なくとも一種以上の、一般式(I)で示される化合物と、少なくとも 一種以上の、少なくとも3つの置換基を有する環状化合物を含んで延伸され、上記レター デーション値Re、Rth、およびRe/Rth比を満たし、膜厚が 20μ m $\sim 160 \mu$ mのセルロースアシレートフイルムは、一枚だけで光学補償シートとして機能する。

[0110]

「偏光板」

偏光板は、偏光膜およびその両側に配置された二枚の透明保護膜からなる。一方の保護 膜として、上記のセルロースアシレートフイルムからなる光学補償シートを用いることが できる。他方の保護膜は、通常のセルロースアセテートフイルムを用いてもよい。

偏光膜には、ヨウ素系偏光膜、二色性染料を用いる染料系偏光膜やポリエン系偏光膜が ある。ヨウ素系偏光膜および染料系偏光膜は、一般にポリビニルアルコール系フイルムを

用いて製造する。

セルロースアシレートフイルムからなる光学補償シートの遅相軸と偏光膜の透過軸とは 、実質的に平行になるように配置する。

[0111]

[偏光度変化]

偏光板の性能は、下記数式(3)で定義される単板透過率及び下記数式(5)で定義さ れる偏光度で評価される。

上述の単板透過率は、JIS Z 8701に基づいて、下記数式(3)で定義される

数式 (3)

[0112]

【数1】

$$T = K \int S(\lambda) y(\lambda) \tau(\lambda) d\lambda$$

[0113]ここで、K、S (λ) 、y (λ) 、 τ (λ) は以下の通りである。 $[0\ 1\ 1\ 4]$ 【数2】

$$K = \frac{100}{\int S(\lambda)y(\lambda)d\lambda}$$

[0115]

S (λ):色の表示に用いる標準光の分光分布

y(λ):ΧΥΖ系における等色関数

τ (λ):分光透過率

数式 (5)

[0116]

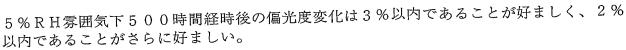
【数3】

偏光度(%)=100×₁

平行透過率、直交透過率は、上述の単板透過率同様、数式(3)で定義される。 [0117]

偏光板は、高湿条件での使用に耐えるため、高湿条件で放置しても偏光度の変化が少な いことが求められる。本発明では、60℃95%RH雰囲気下で500時間経時した前後 での偏光度を測定し、下記式(6)にしたがって偏光度変化を調べた。各透過率は島津自 記分光光度計UV3100にて測定した。

偏光度変化=経時後サンプルの偏光度─経時前サンプルの偏光度 本発明のセルロースアセテートフイルムを偏光板保護膜として使用した場合の60℃9



[0118]

[反射防止層]

偏光板の、液晶セルと反対側に配置される透明保護膜には反射防止層を設けることが好 ましい。特に本発明では透明保護膜上に少なくとも光散乱層と低屈折率層がこの順で積層 した反射防止層又は透明保護膜上に中屈折率層、高屈折率層、低屈折率層がこの順で積層 した反射防止層が好適に用いられる。以下にそれらの好ましい例を記載する。

[0119]

透明保護膜上に光散乱層と低屈折率層を設けた反射防止層の好ましい例について述べる

本発明の光散乱層には、マット粒子が分散しており、光散乱層のマット粒子以外の部分 の素材の屈折率は 1. 50~2.00の範囲にあることが好ましく、低屈折率層の屈折率 は1.35~1.49の範囲にあることが好ましい。本発明においては光散乱層は、防眩 性とハードコート性を兼ね備えており、1層でもよいし、複数層、例えば2層~4層で構 成されていてもよい。

[0120]

反射防止層は、その表面凹凸形状として、中心線平均粗さRaが0.08~0.40μ m、10点平均粗さRzがRaの10倍以下、平均山谷距離Smが1~100μm、凹凸 最深部からの凸部高さの標準偏差が 0.5 μm以下、中心線を基準とした平均山谷距離 S mの標準偏差が 20 μ m以下、傾斜角 0 ~ 5 度の面が 10 %以上となるように設計するこ とで、十分な防眩性と目視での均一なマット感が達成され、好ましい。また、C光源下で の反射光の色味が a *値-2~2、b *値-3~3、380 n m~780 n mの範囲内で の反射率の最小値と最大値の比0.5~0.99であることで、反射光の色味がニュート ラルとなり、好ましい。またC光源下での透過光のb*値が0~3とすることで、表示装 置に適用した際の白表示の黄色味が低減され、好ましい。また、面光源上と本発明の反射 防止フィルムの間に 1 2 0 μ $m \times 4$ 0 μ m の格子を挿入してフィルム上で輝度分布を測定 した際の輝度分布の標準偏差が20以下であると、高精細パネルに本発明のフィルムを適 用したときのギラツキが低減され、好ましい。

[0121]

本発明の反射防止層は、その光学特性として、鏡面反射率2.5%以下、透過率90% 以上、60度光沢度70%以下とすることで、外光の反射を抑制でき、視認性が向上する ため好ましい。特に鏡面反射率は1%以下がより好ましく、0.5%以下であることが最 も好ましい。ヘイズ20%~50%、内部ヘイズ/全ヘイズ値0.3~1、光散乱層まで のヘイズ値から低屈折率層を形成後のヘイズ値の低下が15%以内、くし幅0.5mmに おける透過像鮮明度20%~50%、垂直透過光/垂直から2度傾斜方向の透過率比が1 . 5~5.0とすることで、高精細LCDパネル上でのギラツキ防止、文字等のボケの低 減が達成され、好ましい。

[0122]

[低屈折率層]

本発明の反射防止フィルムの低屈折率層の屈折率は、1.20~1.49であり、好ま しくは $1.30 \sim 1.44$ の範囲にある。さらに、低屈折率層は下記数式 (III) を満た すことが低反射率化の点で好ましい。

数式(III)

 $(m/4) \times 0.$ 7 < $n 1 d 1 < (m/4) \times 1.$ 3

式中、mは正の奇数であり、n1は低屈折率層の屈折率であり、そして、d1は低屈折率 層の膜厚 (nm) である。また、λは波長であり、500~550nmの範囲の値である

[0123]

本発明の低屈折率層を形成する素材について以下に説明する。

本発明の低屈折率層には、低屈折率バインダーとして、含フッ素ポリマーを含む。フッ 素ポリマーとしては動摩擦係数 $0.03\sim0.20$ 、水に対する接触角 $9.0\sim12.0^{\circ}$ 、 純水の滑落角が70°以下の熱または電離放射線により架橋する含フッ素ポリマーが好ま しい。本発明の反射防止フィルムを画像表示装置に装着した時、市販の接着テープとの剥 離力が低いほどシールやメモを貼り付けた後に剥がれ易くなり好ましく、500gf以下 が好ましく、300g f 以下がより好ましく、100g f 以下が最も好ましい。また、微 小硬度計で測定した表面硬度が高いほど、傷がつき難く、0.3GPa以上が好ましく、 0. 5 G P a 以上がより好ましい。

[0124]

低屈折率層に用いられる含フッ素ポリマーとしてはパーフルオロアルキル基含有シラン 化合物 (例えば (ヘプタデカフルオロ-1, 1, 2, 2-テトラヒドロデシル) トリエト キシシラン)の加水分解、脱水縮合物の他、含フッ素モノマー単位と架橋反応性付与のた めの構成単位を構成成分とする含フッ素共重合体が挙げられる。

[0125]

含フッ素モノマー単位の具体例としては、例えばフルオロオレフィン類(例えばフルオ ロエチレン、ビニリデンフルオライド、テトラフルオロエチレン、パーフルオロオクチル エチレン、ヘキサフルオロプロピレン、パーフルオロー2,2ージメチルー1,3ージオ キソール等)、(メタ)アクリル酸の部分または完全フッ素化アルキルエステル誘導体類 (例えばビスコート6FM (大阪有機化学製) やM-2020 (ダイキン製)等)、完全 または部分フッ素化ビニルエーテル類等が挙げられるが、好ましくはパーフルオロオレフ ィン類であり、屈折率、溶解性、透明性、入手性等の観点から特に好ましくはヘキサフル オロプロピレンである。

[0126]

架橋反応性付与のための構成単位としてはグリシジル(メタ)アクリレート、グリシジ ルビニルエーテルのように分子内にあらかじめ自己架橋性官能基を有するモノマーの重合 によって得られる構成単位、カルボキシル基やヒドロキシ基、アミノ基、スルホ基等を有 するモノマー(例えば(メタ)アクリル酸、メチロール(メタ)アクリレート、ヒドロキ シアルキル (メタ) アクリレート、アリルアクリレート、ヒドロキシエチルビニルエーテ ル、ヒドロキシブチルビニルエーテル、マレイン酸、クロトン酸等)の重合によって得ら れる構成単位、これらの構成単位に高分子反応によって(メタ)アクリルロイル基等の架 橋反応性基を導入した構成単位(例えばヒドロキシ基に対してアクリル酸クロリドを作用 させる等の手法で導入できる)が挙げられる。

[0127]

また上記含フッ素モノマー単位、架橋反応性付与のための構成単位以外に溶剤への溶解 性、皮膜の透明性等の観点から適宜フッ素原子を含有しないモノマーを共重合することも できる。併用可能なモノマー単位には特に限定はなく、例えばオレフィン類(エチレン、 プロピレン、イソプレン、塩化ビニル、塩化ビニリデン等)、アクリル酸エステル類(ア クリル酸メチル、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸2-エチルヘキシル)、メタクリル酸エステル類(メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸 ブチル、エチレングリコールジメタクリレート等)、スチレン誘導体(スチレン、ジビニ ルベンゼン、ビニルトルエン、αーメチルスチレン等)、ビニルエーテル類(メチルビニ ルエーテル、エチルビニルエーテル、シクロヘキシルビニルエーテル等)、ビニルエステ ル類(酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、桂皮酸ビニル等)、アクリルアミド類(N-t e r t ーブチルアクリルアミド、N - シクロヘキシルアクリルアミド等)、メタクリルア ミド類、アクリロニトリル誘導体等を挙げることができる。

[0128]

上記のポリマーに対しては特開平10-25388号および特開平10-147739 号各公報に記載のごとく適宜硬化剤を併用しても良い。

[0129]

「光散乱層」

光散乱層は、表面散乱および/または内部散乱による光拡散性と、フィルムの耐擦傷性を向上するためのハードコート性をフィルムに寄与する目的で形成される。従って、ハードコート性を付与するためのバインダー、光拡散性を付与するためのマット粒子、および必要に応じて高屈折率化、架橋収縮防止、高強度化のための無機フィラーを含んで形成される。

[0130]

光散乱層の膜厚は、ハードコート性を付与する目的で、 $1\sim10~\mu$ mが好ましく、 $1.2\sim6~\mu$ mがより好ましい。薄すぎるとハード性が不足し、厚すぎるとカールや脆性が悪化して加工適性が不足となる。

[0131]

散乱層のバインダーとしては、飽和炭化水素鎖またはポリエーテル鎖を主鎖として有するポリマーであることが好ましく、飽和炭化水素鎖を主鎖として有するポリマーであることがさらに好ましい。また、バインダーポリマーは架橋構造を有することが好ましい。飽和炭化水素鎖を主鎖として有するバインダーポリマーとしては、エチレン性不飽和モノマーの重合体が好ましい。飽和炭化水素鎖を主鎖として有し、かつ架橋構造を有するバインダーポリマーとしては、二個以上のエチレン性不飽和基を有するモノマーの(共)重合体が好ましい。バインダーポリマーを高屈折率にするには、このモノマーの構造中に芳香族環や、フッ素以外のハロゲン原子、硫黄原子、リン原子、及び窒素原子から選ばれた少なくとも1種の原子を含むものを選択することもできる。

$[0\ 1\ 3\ 2\]$

二個以上のエチレン性不飽和基を有するモノマーとしては、多価アルコールと(メタ)アクリル酸とのエステル(例、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ブタンジオールジ(メタ)アクリレート、イキサンジオールジ(メタ)アクリレート、1,4ーシクロヘキサンジアクリレート、ペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート)、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、トリメチロールエタントリ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールで、シペンタエリスリトールで、シペンタエリスリトールで、ジペンタエリスリトールで、ジペンタエリスリトールへキサ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールへキサ(メタ)アクリレート、ポリウレタンポリアクリレート、ポリエステルポリアクリレート)、上記のエチレンオキサイド変性体、ビニルベンゼンおよびその誘導体(例、1,4ージビニルベンゼン、4ービニル安息香酸ー2ーアクリロイルエチルエステル、1,4ージビニルシクロへキサノン)、ビニルスルホン(例、ジビニルスルホン)、アクリルアミド(例、メチレンビスアクリルアミド)およびメタクリルアミドが挙げられる。上記モノマーは2種以上併用してもよい。

[0133]

高屈折率モノマーの具体例としては、ビス(4-メタクリロイルチオフェニル)スルフィド、ビニルナフタレン、ビニルフェニルスルフィド、4-メタクリロキシフェニルー4'-メトキシフェニルチオエーテル等が挙げられる。これらのモノマーも2種以上併用してもよい。

[0134]

これらのエチレン性不飽和基を有するモノマーの重合は、光ラジカル開始剤あるいは熱ラジカル開始剤の存在下、電離放射線の照射または加熱により行うことができる。

従って、エチレン性不飽和基を有するモノマー、光ラジカル開始剤あるいは熱ラジカル開始剤、マット粒子および無機フィラーを含有する塗液を調製し、該塗液を透明支持体上に塗布後電離放射線または熱による重合反応により硬化して反射防止膜を形成することができる。これらの光ラジカル開始剤等は公知のものを使用することができる。

[0135]

ポリエーテルを主鎖として有するポリマーは、多官能エポシキシ化合物の開環重合体が好ましい。多官能エポシキ化合物の開環重合は、光酸発生剤あるいは熱酸発生剤の存在下、電離放射線の照射または加熱により行うことができる。

従って、多官能エポシキシ化合物、光酸発生剤あるいは熱酸発生剤、マット粒子および 無機フィラーを含有する塗液を調製し、該塗液を透明支持体上に塗布後電離放射線または 熱による重合反応により硬化して反射防止膜を形成することができる。

[0136]

二個以上のエチレン性不飽和基を有するモノマーの代わりにまたはそれに加えて、架橋 性官能基を有するモノマーを用いてポリマー中に架橋性官能基を導入し、この架橋性官能 基の反応により、架橋構造をバインダーポリマーに導入してもよい。

架橋性官能基の例には、イソシアナート基、エポキシ基、アジリジン基、オキサゾリン 基、アルデヒド基、カルボニル基、ヒドラジン基、カルボキシル基、メチロール基および 活性メチレン基が含まれる。ビニルスルホン酸、酸無水物、シアノアクリレート誘導体、 メラミン、エーテル化メチロール、エステルおよびウレタン、テトラメトキシシランのよ うな金属アルコキシドも、架橋構造を導入するためのモノマーとして利用できる。ブロッ クイソシアナート基のように、分解反応の結果として架橋性を示す官能基を用いてもよい 。すなわち、本発明において架橋性官能基は、すぐには反応を示すものではなくとも、分 解した結果反応性を示すものであってもよい。

これら架橋性官能基を有するバインダーポリマーは塗布後、加熱することによって架橋 構造を形成することができる。

[0137]

光散乱層には、防眩性付与の目的で、フィラー粒子より大きく、平均粒径が $1\sim1$ 0 μ m、好ましくは 1. 5 \sim 7. 0 μ mのマット粒子、例えば無機化合物の粒子または樹脂粒 子が含有される。

上記マット粒子の具体例としては、例えばシリカ粒子、TiO2粒子等の無機化合物の 粒子;アクリル粒子、架橋アクリル粒子、ポリスチレン粒子、架橋スチレン粒子、メラミ ン樹脂粒子、ベンゾグアナミン樹脂粒子等の樹脂粒子が好ましく挙げられる。なかでも架 橋スチレン粒子、架橋アクリル粒子、架橋アクリルスチレン粒子、シリカ粒子が好ましい

マット粒子の形状は、球状あるいは不定形のいずれも使用できる。

[0138]

また、粒子径の異なる2種以上のマット粒子を併用して用いてもよい。より大きな粒子 径のマット粒子で防眩性を付与し、より小さな粒子径のマット粒子で別の光学特性を付与 することが可能である。

[0139]

さらに、上記マット粒子の粒子径分布としては単分散であることが最も好ましく、各粒 子の粒子径は、それぞれ同一に近ければ近いほど良い。例えば平均粒子径よりも20%以 上粒子径が大きな粒子を粗大粒子と規定した場合には、この粗大粒子の割合は全粒子数の 1%以下であることが好ましく、より好ましくは0.1%以下であり、さらに好ましくは 0. 01%以下である。このような粒子径分布を持つマット粒子は通常の合成反応後に、 分級によって得られ、分級の回数を上げることやその程度を強くすることにより、より好 ましい分布のマット剤を得ることができる。

[0140]

上記マット粒子は、形成された光散乱層のマット粒子量が好ましくは10~1000m g/m^2 、より好ましくは $100\sim700$ m g/m^2 となるように光散乱層に含有される。 マット粒子の粒度分布はコールターカウンター法により測定し、測定された分布を粒子 数分布に換算する。

[0141]

光散乱層には、層の屈折率を高めるために、上記のマット粒子に加えて、チタン、ジル コニウム、アルミニウム、インジウム、亜鉛、錫、アンチモンのうちより選ばれる少なく とも 1 種の金属の酸化物からなり、平均粒径が 0. 2μ m以下、好ましくは 0. 1μ m以 下、より好ましくは 0.06μm以下である無機フィラーが含有されることが好ましい。 また逆に、マット粒子との屈折率差を大きくするために、高屈折率マット粒子を用いた 光散乱層では層の屈折率を低目に保つためにケイ素の酸化物を用いることも好ましい。好ましい粒径は前述の無機フィラーと同じである。

光散乱層に用いられる無機フィラーの具体例としては、 TiO_2 、 ZrO_2 、 Al_2O_3 、 In_2O_3 、ZnO、 SnO_2 、 Sb_2O_3 、ITOと SiO_2 等が挙げられる。 TiO_2 および ZrO_2 が高屈折率化の点で特に好ましい。該無機フィラーは表面をシランカップリング処理又はチタンカップリング処理されることも好ましく、フィラー表面にバインダー種と反応できる官能基を有する表面処理剤が好ましく用いられる。

これらの無機フィラーの添加量は、光散乱層の全質量の $10 \sim 90$ %であることが好ましく、より好ましくは $20 \sim 80$ %であり、特に好ましくは $30 \sim 75$ %である。

なお、このようなフィラーは、粒径が光の波長よりも十分小さいために散乱が生じず、 バインダーポリマーに該フィラーが分散した分散体は光学的に均一な物質として振舞う。

[0142]

光散乱層のバインダーおよび無機フィラーの混合物のバルクの屈折率は、1.48~2.00であることが好ましく、より好ましくは1.50~1.80である。屈折率を上記範囲とするには、バインダー及び無機フィラーの種類及び量割合を適宜選択すればよい。どのように選択するかは、予め実験的に容易に知ることができる。

[0143]

光散乱層は、特に塗布ムラ、乾燥ムラ、点欠陥等の面状均一性を確保するために、フッ素系、シリコーン系の何れかの界面活性剤、あるいはその両者を防眩層形成用の塗布組成物中に含有する。特にフッ素系の界面活性剤は、より少ない添加量において、本発明の反射防止フィルムの塗布ムラ、乾燥ムラ、点欠陥等の面状故障を改良する効果が現れるため、好ましく用いられる。面状均一性を高めつつ、高速塗布適性を持たせることにより生産性を高めることが目的である。

[0144]

次に透明保護膜上に中屈折率層、高屈折率層、低屈折率層がこの順で積層した反射防止 層について述べる。

基体上に少なくとも中屈折率層、高屈折率層、低屈折率層(最外層)の順序の層構成から成る反射防止膜は、以下の関係を満足する屈折率を有する様に設計される。

高屈折率層の屈折率>中屈折率層の屈折率>透明支持体の屈折率>低屈折率層の屈折率 又、透明支持体と中屈折率層の間に、ハードコート層を設けてもよい。更には、中屈折率 ハードコート層、高屈折率層及び低屈折率層からなってもよい。

例えば、特開平8-122504号公報、同8-110401号公報、同10-300902号公報、特開2002-243906号公報、特開2000-111706号公報等が挙げられる。又、各層に他の機能を付与させてもよく、例えば、防汚性の低屈折率層、帯電防止性の高屈折率層としたもの(例、特開平10-206603号公報、特開2002-243906号公報等)等が挙げられる。

反射防止膜のヘイズは、5%以下あることが好ましく、3%以下がさらに好ましい。又膜の強度は、JISK5400に従う鉛筆硬度試験でH以上であることが好ましく、2H以上であることがさらに好ましく、3H以上であることが最も好ましい。

[0145]

[高屈折率層および中屈折率層]

反射防止膜の高い屈折率を有する層は、平均粒径 100nm以下の高屈折率の無機化合物超微粒子及びマトリックスバインダーを少なくとも含有する硬化性膜から成る。高屈折率の無機化合物微粒子としては、屈折率 1.65以上の無機化合物が挙げられ、好ましくは屈折率 1.9以上のものが挙げられる。例えば、Ti、Zn、Sb、Sn、Zr、Ce、Ta、La、In等の酸化物、これらの金属原子を含む複合酸化物等が挙げられる。

このような超微粒子とするには、粒子表面が表面処理剤で処理されること(例えば、シランカップリング剤等:特開平11-295503号公報、同11-153703号公報、特開2000-9908、アニオン性化合物或は有機金属カップリング剤:特開2001

- 出証特2005-3029028

-310432号公報等)、高屈折率粒子をコアとしたコアシェル構造とすること(:特開2001-166104等)、特定の分散剤併用(例、特開平11-153703号公報、特許番号US6210858B1、特開2002-2776069号公報等)等挙げられる。

マトリックスを形成する材料としては、従来公知の熱可塑性樹脂、硬化性樹脂皮膜等が挙げられる。

更に、ラジカル重合性及び/又はカチオン重合性の重合性基を少なくとも2個以上含有の多官能性化合物含有組成物、加水分解性基を含有の有機金属化合物及びその部分縮合体組成物から選ばれる少なくとも1種の組成物が好ましい。例えば、特開2000-47004号公報、同2001-315242号公報、同2001-31871号公報、同2001-296401号公報等に記載の化合物が挙げられる。

又、金属アルコキドの加水分解縮合物から得られるコロイド状金属酸化物と金属アルコキシド組成物から得られる硬化性膜も好ましい。例えば、特開2001-293818号公報等に記載されている。

高屈折率層の屈折率は、一般に 1. $70\sim2$. 20 である。高屈折率層の厚さは、 5 n m \sim 1 0 μ m であることが好ましく、 1 0 n m \sim 1 μ m であることがさらに好ましい。

中屈折率層の屈折率は、低屈折率層の屈折率と高屈折率層の屈折率との間の値となるように調整する。中屈折率層の屈折率は、 $1.50\sim1.70$ であることが好ましい。また、厚さは $5~n~m\sim10~\mu~m$ であることが好ましく、 $10~n~m\sim1~\mu~m$ であることがさらに好ましい。

[0146]

[低屈折率層]

低屈折率層は、高屈折率層の上に順次積層して成る。低屈折率層の屈折率は1. 20 ~ 1. 55 である。好ましくは1. 30 ~ 1. 50 である。

耐擦傷性、防汚性を有する最外層として構築することが好ましい。耐擦傷性を大きく向上させる手段として表面への滑り性付与が有効で、従来公知のシリコーンの導入、フッ素の導入等から成る薄膜層の手段を適用できる。

含フッ素化合物の屈折率は $1.35\sim1.50$ であることが好ましい。より好ましくは $1.36\sim1.47$ である。また、含フッ素化合物はフッ素原子を $35\sim80$ 質量%の範囲で含む架橋性若しくは重合性の官能基を含む化合物が好ましい。

例えば、特開平 9-222503 号公報明細書段落番号 $\begin{bmatrix}0018\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}0026\end{bmatrix}$ 、同 11-38202 号公報明細書段落番号 $\begin{bmatrix}0019\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}0030\end{bmatrix}$ 、特開 2001-40284 号公報明細書段落番号 $\begin{bmatrix}0027\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}0028\end{bmatrix}$ 、特開 2000-284102号公報等に記載の化合物が挙げられる。

シリコーン化合物としてはポリシロキサン構造を有する化合物であり、高分子鎖中に硬化性官能基あるいは重合性官能基を含有して、膜中で橋かけ構造をを有するものが好ましい。例えば、反応性シリコーン(例、サイラプレーン(チッソ(株)製等)、両末端にシラノール基含有のポリシロキサン(特開平11-258403号公報等)等が挙げられる

架橋又は重合性基を有する含フッ素及び/又はシロキサンのポリマーの架橋又は重合反応は、重合開始剤、増感剤等を含有する最外層を形成するための塗布組成物を塗布と同時または塗布後に光照射や加熱することにより実施することが好ましい。

又、シランカップリング剤等の有機金属化合物と特定のフッ素含有炭化水素基含有のシランカップリング剤とを触媒共存下に縮合反応で硬化するゾルゲル硬化膜も好ましい。

例えば、ポリフルオロアルキル基含有シラン化合物またはその部分加水分解縮合物(特開昭 58-142958 号公報、同 58-147483 号公報、同 58-147484 号公報、特開平 9-157582 号公報、同 11-106704 号公報記載等記載の化合物)、フッ素含有長鎖基であるポリ「パーフルオロアルキルエーテル」基を含有するシリル化合物(特開 2000-117902 号公報、同 2001-48590 号公報、同 2002-53804 号公報記載の化合物等)等が挙げられる。

低屈折率層は、上記以外の添加剤として充填剤(例えば、二酸化珪素(シリカ)、含フ ッ素粒子(フッ化マグネシウム,フッ化カルシウム,フッ化バリウム)等の一次粒子平均 径が1~150nmの低屈折率無機化合物、特開平11-3820公報の段落番号[00 20]~[0038]に記載の有機微粒子等)、シランカップリング剤、滑り剤、界面活性 剤等を含有することができる。

低屈折率層が最外層の下層に位置する場合、低屈折率層は気相法(真空蒸着法、スパッ タリング法、イオンプレーティング法、プラズマCVD法等)により形成されても良い。 安価に製造できる点で、塗布法が好ましい。

低屈折率層の膜厚は、30~200nmであることが好ましく、50~150nmであ ることがさらに好ましく、60~120 nmであることが最も好ましい。

[0147]

「反射防止層の他の層]

さらに、ハードコート層、前方散乱層、プライマー層、帯電防止層、下塗り層や保護層 等を設けてもよい。

[0148]

[ハードコート層]

ハードコート層は、反射防止層を設けた透明保護膜に物理強度を付与するために、透明 支持体の表面に設ける。特に、透明支持体と前記高屈折率層の間に設けることが好ましい

ハードコート層は、光及び/又は熱の硬化性化合物の架橋反応、又は、重合反応により 形成されることが好ましい。

硬化性官能基としては、光重合性官能基が好ましく、又加水分解性官能基含有の有機金 属化合物は有機アルコキシシリル化合物が好ましい。

これらの化合物の具体例としては、高屈折率層で例示したと同様のものが挙げられる。

ハードコート層の具体的な構成組成物としては、例えば、特開2002-144913 号公報、同2000-9908号公報、WO00/46617号公報等記載のものが挙げ られる。

高屈折率層はハードコート層を兼ねることができる。このような場合、高屈折率層で記 載した手法を用いて微粒子を微細に分散してハードコート層に含有させて形成することが 好ましい。

ハードコート層は、平均粒径 0. 2~10μmの粒子を含有させて防眩機能(アンチグレ ア機能)を付与した防眩層(後述)を兼ねることもできる。

ハードコート層の膜厚は用途により適切に設計することができる。ハードコート層の膜 厚は、 $0.2\sim10\mu$ mであることが好ましく、より好ましくは $0.5\sim7\mu$ mである。 ハードコート層の強度は、JIS K5400に従う鉛筆硬度試験で、H以上であること が好ましく、2 H以上であることがさらに好ましく、3 H以上であることが最も好ましい 。又、JIS K5400に従うテーバー試験で、試験前後の試験片の摩耗量が少ないほ ど好ましい。

[0149]

[帯電防止層]

帯電防止層を設ける場合には体積抵抗率が 10^{-8} (Ω cm $^{-3}$) 以下の導電性を付与するこ とが好ましい。吸湿性物質や水溶性無機塩、ある種の界面活性剤、カチオンポリマー、ア ニオンポリマー、コロイダルシリカ等の使用により 10^{-8} (Ω cm $^{-3}$) の体積抵抗率の付与 は可能であるが、温湿度依存性が大きく、低湿では十分な導電性を確保できない問題があ る。そのため、導電性層素材としては金属酸化物が好ましい。金属酸化物には着色してい るものがあるが、これらの金属酸化物を導電性層素材として用いるとフィルム全体が着色 してしまい好ましくない。着色のない金属酸化物を形成する金属としてZn、 Ti、 Al、 I n、Si、Mg、Ba、Mo、W、 又はVをあげることができ、これれを主成分とした金属酸 化物を用いることが好ましい。具体的な例としては、Zn0、 $Ti0_2$ 、 $Sn0_2$ 、 Al_20_3 、 In_20 $_3$ 、 $Si\,O_2$ 、 MgO、 BaO、 MoO_3 、 $V_2\,O_5$ 等、あるいはこれらの複合酸化物がよく、特にZnO

、 TiO_2 、 及び SnO_2 が好ましい。異種原子を含む例としては、例えばZnOに対してはA1、 In等の添加物、 SnO_2 に対してはSb、Nb、NDの元素等の添加、また TiO_2 に対してはNb、 TA等の添加が効果的である。更にまた、特公昭59-6235号に記載の如く、他の結晶性金属粒子あるいは繊維状物(例えば酸化チタン)に上記の金属酸化物を付着させた素材を使用しても良い。尚、体積抵抗値と表面抵抗値は別の物性値であり単純に比較することはできないが、体積抵抗値で 10^{-8} (Ω cm $^{-3}$)以下の導電性を確保するためには、該導電層が概ね 10^{-10} (Ω / cm 3)以下の表面抵抗値を有していればよく更に好ましくは 10^{-8} (Ω / cm 3) である。導電層の表面抵抗値は帯電防止層を最表層としたときの値として測定されることが必要であり、本特許に記載の積層フィルムを形成する途中の段階で測定することができる。

[0150]

[液晶表示装置]

本発明のセルロースアシレートフィルムを用いた偏光板は、液晶表示装置に有利に用いられる。本発明の偏光板は、様々な表示モードの液晶セルに用いることができる。TN(Twisted Nematic)、IPS(In—Plane Switching)、FLC(Ferroelectric Liauid Crystal)、AFLC(Anti—ferroelectric Liauid Crystal)、OCB(Optically Compensatory Bend)、STN(Supper Twisted Nematic)、VA(Vertically Aligned)およびHAN(Hybrid Aligned Nematic)のような様々な表示モードが提案されている。このうち、OCBモードまたはVAモードに好ましく用いることができる。

[0151]

OCBモードの液晶セルは、棒状液晶性分子を液晶セルの上部と下部とで実質的に逆の方向に(対称的に)配向させるベンド配向モードの液晶セルを用いた液晶表示装置である。OCBモードの液晶セルは、米国特許第4583825号、同5410422号の各明細書に開示されている。棒状液晶分子が液晶セルの上部と下部とで対称的に配向しているため、ベンド配向モードの液晶セルは、自己光学補償機能を有する。そのため、この液晶モードは、OCB(Optically Compensatory Bend)液晶モードとも呼ばれる。ベンド配向モードの液晶表示装置は、応答速度が速いとの利点がある

[0152]

VAモードの液晶セルでは、電圧無印加時に棒状液晶性分子が実質的に垂直に配向している。

VAモードの液晶セルには、(1)棒状液晶性分子を電圧無印加時に実質的に垂直に配向させ、電圧印加時に実質的に水平に配向させる狭義のVAモードの液晶セル(特開平 2 -176625 号公報記載)に加えて、(2)視野角拡大のため、VAモードをマルチドメイン化した(MVAモードの)液晶セル(SID97、Digest of tech. Papers(予稿集) 28(1997)845記載)、(3)棒状液晶性分子を電圧無印加時に実質的に垂直配向させ、電圧印加時にねじれマルチドメイン配向させるモード(n-ASMモード)の液晶セル(日本液晶討論会の予稿集 $58\sim59$ (1998)記載)および(4)SUR VAIVALモードの液晶セル(LCDインターナショナル98で発表)が含まれる。

OCBモードおよびVAモードの液晶表示装置は、液晶セルおよびその両側に二枚の本発明の偏光板を配置してもよいし、VAモードの場合、本発明の偏光板をセルのバックライト側に配置してもよい。そちらの場合も、本発明のセルロースアシレートフィルムが液晶セル側になるよう配置することが好ましい。液晶セルは、二枚の電極基板の間に液晶を担持している。

【実施例】

[0153]

以下、本発明を実施例に基づき具体的に説明するが、本発明は実施例に限定されない。

[0154]

実施例1

[セルロースアシレートフィルムA1の作成]

下記のセルロースアセテート溶液組成の各成分をミキシングタンクに投入し、加熱しながら攪拌して、各成分を溶解し、セルロースアセテート溶液を調製した。

[0155]

(セルロースアセテート溶液組成)

酢化度60.9のセルロースアセテート トリフェニルホスフェート(可塑剤)

ビフェニルジフェニルホスフェート(可塑剤)

メチレンクロライド (第1溶媒)

メタノール(第2溶媒)

シリカ (粒径0.2 μm)

[0156]

100質量部

7.8質量部

3. 9質量部

318質量部

47質量部

0.1質量部

別のミキシングタンクに、下記のレターデーション制御剤 A を 1 0 質量部、レターデーション制御剤 B を 1 0 質量部、メチレンクロライド B 7 質量部およびメタノール B 3 質量部を投入し、加熱しながら攪拌して、レターデーション制御剤溶液 B 0 B 1 を調製した。

セルロースアセテート溶液 4 7 4 質量部にレターデーション制御(上昇)剤溶液 0 1 を 3 6. 2 質量部を混合し、充分に攪拌してドープを調製した。レターデーション調整剤 A 、B の添加量は、セルロースアセテート 1 0 0 質量部に対して、それぞれ、3 質量部であった。

[0157]

レターデーション制御剤A

【化16】

[0158]

レターデーション制御剤B

【化17】

[0159]

得られたドープを、バンド流延機を用いて流延した。延伸開始時の残留溶剤量が32質量%のフィルムを、130℃の条件で、テンターを用いて26%の延伸倍率で横延伸して、セルロースアセテートフィルム(厚さ:92 μ m)を作成した。作製したセルロースアセテートフィルムについて、KOBRA(21ADH、王子計測機器(株)製)を用いて、波長590 μ mにおけるReレターデーション値およびRthレターデーション値を測定した。結果を表1に示す。また、波長分散形状、25℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、寸度

変化率を測定した結果も同様に表1に示す。

[0160]

実施例2

[セルロースアシレートフイルムA2の作成]

延伸倍率を30%にすること以外は実施例1と同様にしてセルロースアセテートフィル ム (厚さ:90μm) を作成した。作製したセルロースアセテートフイルムについて、KO BRA(21ADH、王子計測機器(株)製)を用いて、波長590nmにおけるReレターデ ーション値およびRthレターデーション値を測定した。また、波長分散形状、25℃での 光学性能の湿度依存性、透湿度、寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0161]

実施例3

[セルロースアシレートフイルムA3の作成]

延伸後の膜厚を80 μ mにすること以外は実施例1と同様にしてセルロースアセテート フイルム(厚さ:80μm)を作成した。作製したセルロースアセテートフイルムについ て、KOBRA (2 1 ADH、王子計測機器 (株) 製) を用いて、波長590 n m におけるReレ ターデーション値およびRthレターデーション値を測定した。また、波長分散形状、25 ℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0162]

実施例4

[セルロースアシレートフイルムA4の作成]

セルロースアセテート溶液474質量部にレターデーション制御(上昇)剤溶液01を 31.3質量部を混合したこと以外は実施例1と同様にして、セルロースアセテートフイ ルム (厚さ:92 μ m) を作製した。ドープ中のレターデーション調整剤A、Bの添加量は 、セルロースアセテート100質量部に対して、それぞれ、2.6質量部であった。 作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA (21ADH、王子計測機器 (株

)製)を用いて、波長590nmにおけるReレターデーション値およびRthレターデー ション値を測定した。また、波長分散形状、25℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、 寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0163]

実施例5

[セルロースアシレートフイルムA5の作成]

ミキシングタンクに、前述のレターデーション制御剤Aを2.9質量部、レターデーシ ョン制御剤Bを17.1質量部、メチレンクロライド87質量部およびメタノール13質 量部を投入し、加熱しながら攪拌して、レターデーション制御剤溶液02を調製した。

実施例1のセルロースアセテート溶液474質量部にレターデーション制御(上昇)剤 溶液 0 2 を 4 2. 2 質量部を混合し、充分に攪拌してドープを調製した。レターデーショ ン調整剤Aの添加量はセルロースアセテート100質量部に対して1質量部、レターデー ション調整剤Bの添加量はセルロースアセテート100質量部に対して6質量部であった

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量18%で、テンター延伸機 で横延伸した。延伸倍率は25%としたこと以外は実施例1と同様にしてセルロースアセ テートフィルム (厚さ:92μm) を作成した。

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA (2 1 ADH、王子計測機器(株)製)を用いて、波長590nmにおけるReレターデーション値およびRthレターデー ション値を測定した。また、波長分散形状、25℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、 寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0164]

実施例6

[セルロースアシレートフイルムA6の作成]

ミキシングタンクに、前述のレターデーション制御剤Aを8質量部、レターデーション

出証特2005-3029028

制御剤Bを12質量部、メチレンクロライド87質量部およびメタノール13質量部を投入し、加熱しながら攪拌して、レターデーション制御剤溶液03を調製した。

実施例1のセルロースアセテート溶液474質量部にレターデーション制御(上昇)剤溶液03を30.1質量部を混合し、充分に攪拌してドープを調製した。レターデーション調整剤Aの添加量はセルロースアセテート100質量部に対して2質量部、レターデーション調整剤Bの添加量はセルロースアセテート100質量部に対して3質量部であった

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量 34%で、テンター延伸機で横延伸した。延伸倍率は 26%とし、実施例 1と同様にしてセルロースアセテートフィルム(厚さ: 93μ m)を作成した。

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA(2 1 ADH、王子計測機器(株)製)を用いて、波長 5 9 0 n m における R e レターデーション値および R thレターデーション値を測定した。また、波長分散形状、 2 5 $\mathbb C$ での光学性能の湿度依存性、透湿度、寸度変化率を測定した。結果を表 1 に示す。

[0165]

実施例7

[セルロースアシレートフイルムA7の作成]

ミキシングタンクに、前述のレターデーション制御剤Aを14.3質量部、レターデーション制御剤Bを5.7質量部、メチレンクロライド87質量部およびメタノール13質量部を投入し、加熱しながら攪拌して、レターデーション制御剤溶液 04 を調製した。

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量 30%で、テンター延伸機で横延伸した。延伸倍率は 26%とし、実施例 1と同様にしてセルロースアセテートフィルム(厚さ: 91μ m)を作成した。

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA(2 1 ADH、王子計測機器(株)製)を用いて、波長 5 9 0 n mにおける R e レターデーション値および R thレターデーション値を測定した。また、波長分散形状、2 5 $\mathbb C$ での光学性能の湿度依存性、透湿度、寸度変化率を測定した。結果を表 1 に示す。

[0166]

実施例8

[セルロースアシレートフイルムA8の作成]

ミキシングタンクに、前述のレターデーション制御剤Aを5質量部、下記のレターデーション制御剤Cを5質量部、前述のレターデーション制御剤Bを10質量部、メチレンクロライド87質量部およびメタノール13質量部を投入し、加熱しながら攪拌して、レターデーション制御剤溶液05を調製した。

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量 32%で、テンター延伸機で横延伸した。延伸倍率は 26%とし、実施例 1と同様にしてセルロースアセテートフィルム(厚さ: 90μ m)を作成した。

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA(2 1 ADH、王子計測機器(株)製)を用いて、波長590nmにおけるReレターデーション値およびRthレターデー

ション値を測定した。また、波長分散形状、25℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、 寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0167]

レターデーション制御剤C

【化18】

[0168]

実施例 9

[セルロースアシレートフイルムA9の作成]

ミキシングタンクに、前述のレターデーション制御剤Aを10質量部、レターデーショ ン制御剤Bを5質量部、下記式のレターデーション制御剤Dを5質量部、メチレンクロラ イド87質量部およびメタノール13質量部を投入し、加熱しながら攪拌して、レターデ ーション制御剤溶液06を調製した。

実施例1のセルロースアセテート溶液474質量部にレターデーション制御(上昇)剤 溶液06を36.2質量部を混合し、充分に攪拌してドープを調製した。レターデーショ ン調整剤Aの添加量はセルロースアセテート100質量部に対して3質量部、レターデー ション制御剤Bの添加量はセルロースアセテート100質量部に対して1.5質量部、レ ターデーション調整剤Dの添加量はセルロースアセテート100質量部に対して1.5質 量部であった。

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量33%で、テンター延伸機 で横延伸した。延伸倍率は26%とし、実施例1と同様にしてセルロースアセテートフィ ルム (厚さ:93μm) を作成した。

作製したセルロースアセテートフィルムについて、KOBRA (2 1 ADH、王子計測機器 (株)製)を用いて、波長590nmにおけるReレターデーション値およびRthレターデー ション値を測定した。また、波長分散形状、25℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、 寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0169]

レターデーション制御剤D

【化19】

[0170]

実施例10

[セルロースアシレートフイルムA10の作成]

ミキシングタンクに、前述のレターデーション制御剤Cを10質量部、レターデーショ ン制御剤Bを10質量部、メチレンクロライド87質量部およびメタノール13質量部を 投入し、加熱しながら攪拌して、レターデーション制御剤溶液07を調製した。

実施例1のセルロースアセテート溶液474質量部にレターデーション制御(上昇)剤溶液07を36.2質量部を混合し、充分に攪拌してドープを調製した。レターデーション制御剤Cの添加量はセルロースアセテート100質量部に対して3質量部、レターデーション制御剤Bの添加量はセルロースアセテート100質量部に対して3質量部であった

[0171]

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量 31%で、テンター延伸機で横延伸した。延伸倍率は 26%とし、実施例 1と同様にしてセルロースアセテートフィルム(厚さ: 92μ m)を作成した。

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA(2 1 ADH、王子計測機器(株)製)を用いて、波長 5 9 0 n mにおける R e レターデーション値および R thレターデーション値を測定した。また、波長分散形状、2 5 $\mathbb C$ での光学性能の湿度依存性、透湿度、寸度変化率を測定した。結果を表 1 に示す。

[0172]

実施例11

[セルロースアシレートフイルムA11の作成]

下記のセルロースアセテート溶液組成の各成分をミキシングタンクに投入し、加熱しながら攪拌して、各成分を溶解し、セルロースアシレート溶液を調製した。

[0173]

(セルロースアシレート溶液組成)

アセチル基の置換度1.90、プロピオニル基の置換度0.80のセルロースアセテートプロピオネート 100質量部

トリフェニルホスフェート

エチルフタリルエチルグリコレート

メチレンクロライド

エタノール

8. 5質量部

2. 0 質量部

2 9 0 質量部

6 0 質量部

[0174]

別のミキシングタンクに、セルロースアセテートプロピオネート5質量部、チヌビン326 (チバ・スペシャルティ・ケミカルズ (株)製)6質量部、チヌビン109 (チバ・スペシャルティ・ケミカルズ (株)製)4質量部、チヌビン171 (チバ・スペシャルティ・ケミカルズ (株)製)5質量部、前述のレターデーション制御剤Aを8.3質量部、レターデーション制御剤Bを8.3質量部、を塩化メチレン94質量部とエタノール8質量部を投入し、加熱しながら攪拌して、添加剤溶液1を調製した。

セルロースアセテート溶液 4 7 4 質量部に添加剤溶液 1 を 7 3 質量部混合し、充分に攪拌してドープを調製した。

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量 32%で、テンター延伸機で横延伸した。延伸倍率は 26%とし、実施例 1と同様にしてセルロースアセテートフィルム(厚さ: 80μ m)を作成した。

[0175]

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA(2 1 ADH、王子計測機器(株)製)を用いて、波長 5 9 0 n mにおけるR e レターデーション値およびR thレターデーション値を測定した。また、波長分散形状、25℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、寸度変化率を測定した。結果を表 1 に示す。

[0176]

実施例12

[セルロースアシレートフイルムA12の作成]

下記のセルロースアセテート溶液組成の各成分をミキシングタンクに投入し、加熱しながら攪拌して、各成分を溶解し、セルロースアシレート溶液を調製した。

[0177]

(セルロースアシレート溶液組成)

アセチル基の置換度0.18、プロピオニル基の置換度2.47のセルロースアセテー

トプロピオネート

100質量部

トリフェニルホスフェート

8.0質量部

エチルフタリルエチルグリコレート

4.0質量部

メチレンクロライド

403質量部

エタノール

6 0.3 質量部

[0178]

別のミキシングタンクに、前述のレターデーション制御剤Aを12.0質量部、レター デーション制御剤Bを8.0質量部、を塩化メチレン87質量部とエタノール13質量部 を投入し、加熱しながら攪拌して、添加剤溶液2を調製した。

セルロースアセテート溶液474質量部に添加剤溶液2を9.9質量部混合し、充分に 攪拌してドープを調製した。

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量32%で、テンター延伸機 で横延伸した。延伸倍率は23%とし、実施例1と同様にしてセルロースアセテートフィ ルム (厚さ:80 μm) を作成した。

[0179]

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA(21ADH、王子計測機器(株)製)を用いて、波長590nmにおけるReレターデーション値およびRthレターデー ション値を測定した。また、波長分散形状、25℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、 寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0180]

実施例13

[セルロースアシレートフイルムA13の作成]

下記のセルロースアセテート溶液組成の各成分をミキシングタンクに投入し、加熱しな がら攪拌して、各成分を溶解し、セルロースアシレート溶液を調製した。

[0181]

(セルロースアシレート溶液組成)

アセチル基の置換度1.40、ブチリル基の置換度1.30のセルロースアセテートブ 100質量部 チレート

トリフェニルホスフェート

8.5質量部

エチルフタリルエチルグリコレート

2. 0 質量部

290質量部

メチレンクロライド

エタノール

60質量部

[0182]

別のミキシングタンクに、セルロースアセテートブチレート5質量部、チヌビン326 (チバ・スペシャルティ・ケミカルズ(株)製) 6質量部、チヌビン109 (チバ・スペ シャルティ・ケミカルズ(株)製)4質量部、チヌビン171(チバ・スペシャルティ・ ケミカルズ (株) 製) 5質量部、前述のレターデーション制御剤Aを10.0質量部、レ ターデーション制御剤Bを 6. 6 質量部、を塩化メチレン 9 4 質量部とエタノール 8 質量 部を投入し、加熱しながら攪拌して、添加剤溶液3を調製した。

セルロースアセテート溶液474質量部に添加剤溶液3を43.5質量部混合し、充分 に攪拌してドープを調製した。

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量28%で、テンター延伸機 で横延伸した。延伸倍率は18%とし、実施例1と同様にしてセルロースアセテートフィ ルム (厚さ: 80 μm) を作成した。

[0183]

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA(21ADH、王子計測機器(株) 製) を用いて、波長590 nmにおけるReレターデーション値およびRthレターデー ション値を測定した。また、波長分散形状、25℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、

寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0184]

実施例14

[セルロースアシレートフイルムA14の作成]

下記のセルロースアセテート溶液組成の各成分をミキシングタンクに投入し、加熱しな がら攪拌して、各成分を溶解し、セルロースアシレート溶液を調製した。

[0185]

(セルロースアシレート溶液組成)

アセチル基の置換度 0.30、ブチリル基の置換度 2.50のセルロースアセテートブ 100質量部

チレート

トリフェニルホスフェート

エチルフタリルエチルグリコレート

メチレンクロライド

エタノール

8.0質量部

4. 0 質量部

4 0 3 質量部

6 0.3 質量部

別のミキシングタンクに、前述のレターデーション制御剤Aを12.9質量部、レター デーション制御剤Bを7.1質量部、を塩化メチレン87質量部とエタノール13質量部 を投入し、加熱しながら攪拌して、添加剤溶液4を調製した。

セルロースアセテート溶液474質量部に添加剤溶液4を22.3質量部混合し、充分 に攪拌してドープを調製した。

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量34%で、テンター延伸機 で横延伸した。延伸倍率は30%とし、実施例1と同様にしてセルロースアセテートフィ ルム (厚さ: $70\mu m$) を作成した。

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA (2 1 ADH、王子計測機器 (株)製)を用いて、波長590nmにおけるReレターデーション値およびRthレターデー ション値を測定した。また、波長分散形状、25℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、 寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0188]

実施例15

[セルロースアシレートフイルムA15の作成]

下記のセルロースアセテート溶液組成の各成分をミキシングタンクに投入し、加熱しなが ら攪拌して、各成分を溶解し、セルロースアセテート溶液を調製した。

[0189]

(セルロースアセテート溶液組成)

アセチル基の置換度2.78、アセチル基の6位置換度/全置換度0.33のセルロー 100質量部

スアセテート

8. 0 質量部

トリフェニルホスフェート (可塑剤)

4. 0 質量部

ビフェニルジフェニルホスフェート (可塑剤)

4 0 3 質量部

メチレンクロライド(第1溶媒)

60.2質量部

メタノール(第2溶媒)

0. 1質量部

シリカ (粒径0.2μm)

ここで、アセチル基の置換度とは (DS2+DS3+DS6) のこと、アセチル基 の 6 位置換度/全置換度とは (DS6/(DS2+DS3+DS6)) のことであり 、DS2、DS3、DS6はそれぞれ、セルロースを構成するグルコース単位の2位、3 位、6位の水酸基のアシル基による置換度である。

別のミキシングタンクに、レターデーション制御剤Aを13.1質量部、レターデーシ ョン制御剤Bを 6.9質量部、メチレンクロライド87質量部およびメタノール13質量 部を投入し、加熱しながら攪拌して、レターデーション制御剤溶液08を調製した。

セルロースアセテート溶液474質量部にレターデーション制御(上昇)剤溶液01を 17.3質量部を混合し、充分に攪拌してドープを調製した。レターデーション調整剤A の添加量はセルロースアセテート100質量部に対して2.3質量部、レターデーション 調整剤Bの添加量は、セルロースアセテート100質量部に対して1.2質量部であった

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量32%で、テンター延伸機 で横延伸した。延伸倍率は28%とし、実施例1と同様にしてセルロースアセテートフィ ルム (厚さ: 70 μm) を作成した。

[0191]

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA (2 1 ADH、王子計測機器 (株)製)を用いて、波長590nmにおけるReレターデーション値およびRthレターデー ション値を測定した。また、波長分散形状、25℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、 寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0192]

実施例16

[セルロースアシレートフイルムA16の作成]

下記のセルロースアセテート溶液組成の各成分をミキシングタンクに投入し、加熱しなが ら攪拌して、各成分を溶解し、セルロースアセテート溶液を調製した。

[0193]

(セルロースアセテート溶液組成)

アセチル基の置換度2.75、アセチル基の6位置換度/全置換度0.35のセルロー 100質量部

スアセテート

8. 0 質量部

トリフェニルホスフェート(可塑剤)

4.0質量部

ビフェニルジフェニルホスフェート (可塑剤) メチレンクロライド (第1溶媒)

4 0 3 質量部

メタノール(第2溶媒)

60.2質量部

シリカ (粒径 0.2 µ m)

0.1質量部

[0194]

別のミキシングタンクに、レターデーション制御剤Aを12.0質量部、レターデーシ ョン制御剤Bを8.0質量部、メチレンクロライド87質量部およびメタノール13質量 部を投入し、加熱しながら攪拌して、レターデーション制御剤溶液 0 9 を調製した。 セルロースアセテート溶液474質量部にレターデーション制御(上昇)剤溶液01を9 9 質量部を混合し、充分に攪拌してドープを調製した。レターデーション調整剤Aの添 加量はセルロースアセテート100質量部に対して1.2質量部、レターデーション調整 剤Bの添加量は、セルロースアセテート100質量部に対して0.8質量部であった。

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量30%で、テンター延伸機 で横延伸した。延伸倍率は30%とし、実施例1と同様にしてセルロースアセテートフィ ルム (厚さ:90μm) を作成した。

[0195]

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA (2 1 ADH、王子計測機器 (株)製)を用いて、波長590nmにおけるReレターデーション値およびRthレターデー ション値を測定した。また、波長分散形状、25℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、 寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0196]

実施例17

[セルロースアシレートフイルムA17の作成]

下記のセルロースアセテート溶液組成の各成分をミキシングタンクに投入し、加熱しな がら攪拌して、各成分を溶解し、セルロースアセテート溶液を調製した。

$[0\ 1\ 9\ 7\]$

(セルロースアセテート溶液組成)

0.1質量部

アセチル基の置換度2.78、アセチル基の6位置換度/全置換度0.33のセルロー 100質量部 スアセテート

8.0質量部 トリフェニルホスフェート(可塑剤) 4.0質量部 ビフェニルジフェニルホスフェート(可塑剤)

403質量部 メチレンクロライド(第1溶媒) 60.2質量部 メタノール(第2溶媒)

シリカ (粒径 0.2μm)

[0198]

別のミキシングタンクに、レターデーション制御剤Aを12.0質量部、レターデーシ ョン制御剤Bを8.0質量部、メチレンクロライド87質量部およびメタノール13質量 部を投入し、加熱しながら攪拌して、レターデーション制御剤溶液10を調製した。 セルロースアセテート溶液474質量部にレターデーション制御(上昇)剤溶液01を1 9. 8質量部を混合し、充分に攪拌してドープを調製した。レターデーション調整剤Aの 添加量はセルロースアセテート100質量部に対して2.4質量部、レターデーション調 整剤Bの添加量は、セルロースアセテート100質量部に対して1.6質量部であった。 バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量28%で、テンター延伸機 で横延伸した。延伸倍率は25%とし、実施例1と同様にしてセルロースアセテートフィ ルム (厚さ: 80 μm) を作成した。

[0199]

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA (21ADH、王子計測機器 (株)製)を用いて、波長590nmにおけるReレターデーション値およびRthレターデー ション値を測定した。また、波長分散形状、25℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、 寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0200]

実施例18

[セルロースアシレートフイルムA18の作成]

下記のセルロースアセテート溶液組成の各成分をミキシングタンクに投入し、加熱しな がら攪拌して、各成分を溶解し、セルロースアセテート溶液を調製した。

[0201]

(セルロースアセテート溶液組成)

アセチル基の置換度2.75、アセチル基の6位置換度/全置換度0.35のセルロー 100質量部

スアセテート 8.0質量部 トリフェニルホスフェート(可塑剤)

4. 0 質量部 ビフェニルジフェニルホスフェート(可塑剤) 4 0 3 質量部 メチレンクロライド(第1溶媒)

60.2質量部 メタノール(第2溶媒) 0.1質量部

シリカ (粒径 0.2 μm)

[0202]

別のミキシングタンクに、レターデーション制御剤Aを10.7質量部、レターデーシ ョン制御剤Bを9.3質量部、メチレンクロライド87質量部およびメタノール13質量 部を投入し、加熱しながら攪拌して、レターデーション制御剤溶液11を調製した。 セルロースアセテート溶液474質量部にレターデーション制御剤溶液11を14.8質 量部を混合し、充分に攪拌してドープを調製した。レターデーション調整剤Aの添加量は セルロースアセテート100質量部に対して1.6質量部、レターデーション調整剤Bの 添加量は、セルロースアセテート100質量部に対して1.4質量部であった。

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量31%で、テンター延伸機 で横延伸した。延伸倍率は20%とし、実施例1と同様にしてセルロースアセテートフィ ルム (厚さ: 9 0 μm) を作成した。

[0203]

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA (21ADH、王子計測機器 (株 出証特2005-3029028) 製) を用いて、波長590nmにおけるReレターデーション値およびRthレターデー ション値を測定した。また、波長分散形状、25℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、 寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0204]

実施例19

[セルロースアシレートフィルムA19の作成]

実施例1で作製した、セルロースアセテート溶液474質量部にレターデーション制御 (上昇) 剤溶液 0 1 を 2 4. 7 質量部を混合し、充分に攪拌してドープを調製した。レタ ーデーション調整剤A、Bの添加量は、セルロースアセテート100質量部に対して、それ ぞれ、2.5質量部であった。

[0205]

残留溶媒量が30%であったことと、延伸倍率を25%にすること以外は実施例1と同 様にしてセルロースアセテートフイルム(厚さ:110μm)を作製した。作製したセル ロースアセテートフイルムについて、KOBRA (21ADH、王子計測機器(株)製)を用いて 、波長590nmにおけるReレターデーション値およびRthレターデーション値を測定 した。また、波長分散形状、25℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、寸度変化率を測 定した。結果を表1に示す。

[0206]

実施例20

[セルロースアシレートフイルムA20の作成]

下記のセルロースアセテート溶液組成の各成分をミキシングタンクに投入し、加熱しな がら攪拌して、各成分を溶解し、セルロースアシレート溶液を調製した。

[0207]

(セルロースアシレート溶液組成)

アセチル基の置換度1.90、プロピオニル基の置換度0.80のセルロースアセテー 100質量部

トプロピオネート

8.0質量部

トリフェニルホスフェート

4.0質量部

エチルフタリルエチルグリコレート

4 0 3 質量部

メチレンクロライド

60.3質量部

エタノール

[0208]

別のミキシングタンクに、前述のレターデーション制御剤Aを12.0質量部、レター デーション制御剤Bを8.0質量部、を塩化メチレン87質量部とエタノール13質量部 を投入し、加熱しながら攪拌して、添加剤溶液5を調製した。

セルロースアセテート溶液474質量部に添加剤溶液5を24.7質量部混合し、充分 に攪拌してドープを調製した。

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量34%で、テンター延伸機 で横延伸した。延伸倍率は21%とし、実施例1と同様にしてセルロースアセテートフィ ルム (厚さ:80μm) を作製した。

[0209]

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA (21ADH、王子計測機器(株)製)を用いて、波長590nmにおけるReレターデーション値およびRthレターデー ション値を測定した。また、波長分散形状、25℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、 寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0210]

実施例 2 1

[セルロースアシレートフイルムA21の作成]

下記のセルロースアセテート溶液組成の各成分をミキシングタンクに投入し、加熱しな がら攪拌して、各成分を溶解し、セルロースアシレート溶液を調製した。

[0211]

(セルロースアシレート溶液組成)

アセチル基の置換度 0. 18、プロピオニル基の置換度 2. 47のセルロースアセテー

トプロピオネート

100質量部

トリフェニルホスフェート

8.5質量部

エチルフタリルエチルグリコレート

2.0質量部 290質量部

メチレンクロライド エタノール

6 0 質量部

[0212]

別のミキシングタンクに、セルロースアセテートプロピオネート5質量部、チヌビン3 26 (チバ・スペシャルティ・ケミカルズ(株)製)6質量部、チヌビン109 (チバ・ スペシャルティ・ケミカルズ(株)製)4質量部、チヌビン171 (チバ・スペシャルテ イ・ケミカルズ (株) 製) 5質量部、前述のレターデーション制御剤Aを11.6質量部 、レターデーション制御剤Bを5.0質量部、を塩化メチレン94質量部とエタノール8 質量部を投入し、加熱しながら攪拌して、添加剤溶液6を調製した。

セルロースアセテート溶液474質量部に添加剤溶液6を28.8質量部混合し、充分 に攪拌してドープを調製した。

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量30%で、テンター延伸機 で横延伸した。延伸倍率は25%とし、実施例1と同様にしてセルロースアセテートフィ ルム(厚さ:70μm)を作成した。

[0213]

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA (21 ADH、王子計測機器 (株) 製) を用いて、波長590 nmにおけるReレターデーション値およびRthレターデー ション値を測定した。また、波長分散形状、25℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、 寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0214]

実施例22

[セルロースアシレートフイルムA22の作成]

下記のセルロースアセテート溶液組成の各成分をミキシングタンクに投入し、加熱しな がら攪拌して、各成分を溶解し、セルロースアシレート溶液を調製した。

[0215]

(セルロースアシレート溶液組成)

アセチル基の置換度1.40、ブチリル基の置換度1.30のセルロースアセテートブ 100質量部 チレート

トリフェニルホスフェート

8.0質量部

エチルフタリルエチルグリコレート

4.0質量部

メチレンクロライド

4 0 3 質量部

エタノール

60.3質量部

[0216]

別のミキシングタンクに、前述のレターデーション制御剤Aを8.0質量部、レターデ ーション制御剤Bを12.0質量部、を塩化メチレン87質量部とエタノール13質量部 を投入し、加熱しながら攪拌して、添加剤溶液7を調製した。

セルロースアセテート溶液474質量部に添加剤溶液7を19.8質量部混合し、充分 に攪拌してドープを調製した。

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量28%で、テンター延伸機 で横延伸した。延伸倍率は28%とし、実施例1と同様にしてセルロースアセテートフィ ルム (厚さ:80μm) を作成した。

[0217]

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA(21ADH、王子計測機器(株) 製) を用いて、波長590nmにおけるReレターデーション値およびRthレターデー ション値を測定した。また、波長分散形状、25℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、

寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0218]

実施例23

「セルロースアシレートフイルムA23の作成]

下記のセルロースアセテート溶液組成の各成分をミキシングタンクに投入し、加熱しな がら攪拌して、各成分を溶解し、セルロースアシレート溶液を調製した。

[0219]

(セルロースアシレート溶液組成)

アセチル基の置換度 0.30、ブチリル基の置換度 2.50のセルロースアセテートブ 100質量部 チレート

トリフェニルホスフェート エチルフタリルエチルグリコレート メチレンクロライド

2. 0 質量部 290質量部 60質量部

8.5質量部

エタノール

[0220]

別のミキシングタンクに、セルロースアセテートブチレート5質量部、チヌビン326 (チバ・スペシャルティ・ケミカルズ(株)製) 6質量部、チヌビン109 (チバ・スペ シャルティ・ケミカルズ(株)製)4質量部、チヌビン171(チバ・スペシャルティ・ ケミカルズ (株) 製) 5質量部、前述のレターデーション制御剤Aを10.0質量部、レ ターデーション制御剤Bを 6.6質量部、を塩化メチレン 9.4質量部とエタノール 8質量 部を投入し、加熱しながら攪拌して、添加剤溶液8を調製した。

セルロースアセテート溶液 4 7 4 質量部に添加剤溶液 8 を 4 3.5 質量部混合し、充分 に攪拌してドープを調製した。

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量32%で、テンター延伸機 で横延伸した。延伸倍率は25%とし、実施例1と同様にしてセルロースアセテートフィ ルム (厚さ:90μm)を作成した。

[0221]

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA (2 1 ADH、王子計測機器 (株)製)を用いて、波長590nmにおけるReレターデーション値およびRthレターデー ション値を測定した。また、波長分散形状、25℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、 寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0222]

実施例24

[セルロースアシレートフイルムA24の作成]

下記のセルロースアセテート溶液組成の各成分をミキシングタンクに投入し、加熱しなが ら攪拌して、各成分を溶解し、セルロースアセテート溶液を調製した。

[0223]

(セルロースアセテート溶液組成)

アセチル基の置換度2.78、アセチル基の6位置換度/全置換度0.33のセルロー 100質量部

スアセテート トリフェニルホスフェート(可塑剤)

8.0質量部

ビフェニルジフェニルホスフェート(可塑剤)

4. 0 質量部 4 0 3 質量部

メチレンクロライド(第1溶媒) メタノール(第2溶媒)

60.2質量部

シリカ(粒径0.2 µ m)

0.1質量部

[0224]

別のミキシングタンクに、レターデーション制御剤Aを12.0質量部、レターデーシ ョン制御剤Bを8.0質量部、メチレンクロライド87質量部およびメタノール13質量 部を投入し、加熱しながら攪拌して、レターデーション制御剤溶液12を調製した。 セルロースアセテート溶液474質量部にレターデーション制御剤溶液12を24.7質 量部を混合し、充分に攪拌してドープを調製した。レターデーション調整剤Aの添加量は セルロースアセテート100質量部に対して3.0質量部、レターデーション調整剤Bの 添加量は、セルロースアセテート100質量部に対して2.0質量部であった。

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量28%で、テンター延伸機 で横延伸した。延伸倍率は23%とし、実施例1と同様にしてセルロースアセテートフィ ルム(厚さ: $100\mu m$)を作成した。

[0225]

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA (2 1 ADH、王子計測機器 (株)製)を用いて、波長590nmにおけるReレターデーション値およびRthレターデー ション値を測定した。また、波長分散形状、25℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、 寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0226]

実施例 2 5

[セルロースアシレートフイルムA25の作成]

延伸倍率を26%にすること以外は実施例24と同様にしてセルロースアセテートフィ ルム (厚さ: $100\mu m$) を作成した。

[0227]

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA (2 1 ADH、王子計測機器 (株)製)を用いて、波長590nmにおけるReレターデーション値およびRthレターデー ション値を測定した。また、波長分散形状、25℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、 寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0228]

実施例 2 6

[セルロースアシレートフイルムA26の作成]

下記のセルロースアセテート溶液組成の各成分をミキシングタンクに投入し、加熱しなが ら攪拌して、各成分を溶解し、セルロースアセテート溶液を調製した。

[0229]

(セルロースアセテート溶液組成)

アセチル基の置換度2.75、アセチル基の6位置換度/全置換度0.35のセルロー 100質量部 スアセテート

トリフェニルホスフェート(可塑剤)

ビフェニルジフェニルホスフェート(可塑剤)

メチレンクロライド(第1溶媒)

メタノール(第2溶媒)

シリカ (粒径 0.2 μm)

8. 0質量部

4. 0 質量部

4 0 3 質量部

60.2質量部

0.1質量部

[0230]

別のミキシングタンクに、レターデーション制御剤Aを10.0質量部、レターデーシ ョン制御剤Bを10.0質量部、メチレンクロライド87質量部およびメタノール13質 量部を投入し、加熱しながら攪拌して、レターデーション制御剤溶液13を調製した。

セルロースアセテート溶液474質量部にレターデーション制御剤溶液13を29.2 質量部を混合し、充分に攪拌してドープを調製した。レターデーション調整剤Aの添加量 はセルロースアセテート100質量部に対して3.0質量部、レターデーション調整剤B の添加量は、セルロースアセテート100質量部に対して3.0質量部であった。

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量34%で、テンター延伸機 で横延伸した。延伸倍率は32%とし、実施例1と同様にしてセルロースアセテートフィ ルム (厚さ: $80\mu m$) を作成した。

[0231]

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA (2 1 ADH、王子計測機器 (株)製)を用いて、波長590nmにおけるReレターデーション値およびRthレターデー ション値を測定した。また、波長分散形状、25℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、

寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0232]

実施例27

[セルロースアシレートフイルムA27の作成]

下記のセルロースアセテート溶液組成の各成分をミキシングタンクに投入し、加熱しな がら攪拌して、各成分を溶解し、セルロースアセテート溶液を調製した。

[0233]

(セルロースアセテート溶液組成)

アセチル基の置換度2.82、アセチル基の6位置換度/全置換度0.32のセルロー

スアセテート

100質量部

トリフェニルホスフェート(可塑剤)

8.0質量部

ビフェニルジフェニルホスフェート(可塑剤)

4.0質量部

メチレンクロライド(第1溶媒)

403質量部

メタノール(第2溶媒)

60.2質量部

シリカ (粒径 0.2 μm)

0.1質量部

[0234]

別のミキシングタンクに、レターデーション制御剤Aを10.0質量部、レターデーシ ョン制御剤Bを10.0質量部、メチレンクロライド87質量部およびメタノール13質 量部を投入し、加熱しながら攪拌して、レターデーション制御剤溶液14を調製した。 セルロースアセテート溶液474質量部にレターデーション制御剤溶液14を31.1質 量部を混合し、充分に攪拌してドープを調製した。レターデーション調整剤Aの添加量は セルロースアセテート100質量部に対して3.8質量部、レターデーション調整剤Bの 添加量は、セルロースアセテート100質量部に対して2.5質量部であった。

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量30%で、テンター延伸機 で横延伸した。延伸倍率は25%とし、実施例1と同様にしてセルロースアセテートフィ ルム (厚さ: 90 μm) を作成した。

[0235]

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA (21ADH、王子計測機器 (株) 製) を用いて、波長590 n m におけるR e レターデーション値およびR thレターデー ション値を測定した。また、波長分散形状、25℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、 寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0236]

実施例28

[セルロースアシレートフイルムA27の作成]

下記のセルロースアセテート溶液組成の各成分をミキシングタンクに投入し、加熱しな がら攪拌して、各成分を溶解し、セルロースアセテート溶液を調製した。

[0237]

(セルロースアセテート溶液組成)

アセチル基の置換度2.80、アセチル基の6位置換度/全置換度0.32のセルロー

スアセテート

100質量部

トリフェニルホスフェート(可塑剤)

8.0質量部

ビフェニルジフェニルホスフェート(可塑剤)

4. 0 質量部

メチレンクロライド(第1溶媒)

403質量部

メタノール(第2溶媒)

60.2質量部 0.1質量部

シリカ (粒径 0.2 μ m)

[0238]

別のミキシングタンクに、レターデーション制御剤Aを14.0質量部、レターデーシ ョン制御剤Bを 6.0質量部、メチレンクロライド87質量部およびメタノール13質量 部を投入し、加熱しながら攪拌して、レターデーション制御剤溶液15を調製した。 セルロースアセテート溶液474質量部にレターデーション制御剤溶液15を32.6質 量部を混合し、充分に攪拌してドープを調製した。レターデーション調整剤Aの添加量はセルロースアセテート100質量部に対して4.6質量部、レターデーション調整剤Bの添加量は、セルロースアセテート100質量部に対して2.0質量部であった。

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量32%で、テンター延伸機で横延伸した。延伸倍率は20%とし、実施例1と同様にしてセルロースアセテートフィルム(厚さ:60 μ m)を作成した。

[0239]

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA(2 1 ADH、王子計測機器(株)製)を用いて、波長 5 9 0 n m における R e レターデーション値および R thレターデーション値を測定した。また、波長分散形状、 2 5 $\mathbb C$ での光学性能の湿度依存性、透湿度、寸度変化率を測定した。結果を表 1 に示す。

[0240]

比較例1

[セルロースアシレートフイルムB1の作成]

ミキシングタンクに、前述のレターデーション制御剤Aを20質量部、メチレンクロライド87質量部およびメタノール13質量部を投入し、加熱しながら攪拌して、レターデーション制御剤溶液08を調製した。

実施例1のセルロースアセテート溶液474質量部にレターデーション制御(上昇)剤溶液08を36.2質量部を混合し、充分に攪拌してドープを調製した。レターデーション制御剤Aの添加量はセルロースアセテート100質量部に対して6質量部であった。

[0241]

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量 2.8%で、テンター延伸機で横延伸した。延伸倍率は 2.6%とし、実施例 1と同様にしてセルロースアセテートフィルム(厚さ: $9.3~\mu$ m)を作成した。

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA(2 1 ADH、王子計測機器(株)製)を用いて、波長 5 9 0 n m における R e レターデーション値および R thレターデーション値を測定した。また、波長分散形状、 2 5 $\mathbb C$ での光学性能の湿度依存性、透湿度、寸度変化率を測定した。結果を表 1 に示す。

[0242]

比較例 2

[セルロースアシレートフイルムB2の作成]

実施例1のセルロースアセテート溶液474質量部にレターデーション制御(上昇)剤溶液08を45.2質量部を混合し、充分に攪拌してドープを調製した。レターデーション調整剤Aの添加量はセルロースアセテート100質量部に対して7.5質量部であった

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量 26%で、テンター延伸機で横延伸した。延伸倍率は 26%とし、実施例 1と同様にしてセルロースアセテートフィルム(厚さ: 90μ m)を作成した。

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA(2 1 ADH、王子計測機器(株)製)を用いて、波長5 9 0 n mにおけるR e レターデーション値およびR thレターデーション値を測定した。また、波長分散形状、25℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0243]

比較例3

[セルロースアシレートフイルムB3の作成]

延伸倍率を 30% にしたこと以外は比較例 2 と同様にして、セルロースアセテートフィルム(厚さ: 89μ m)を作製した。

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA(2 1 ADH、王子計測機器(株)製)を用いて、波長590 n m におけるR e レターデーション値およびR thレターデーション値を測定した。また、波長分散形状、25℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、

寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0244]

比較例 4

「セルロースアシレートフイルムB4の作成]

実施例1のセルロースアセテート溶液474質量部にレターデーション制御(上昇)剤 溶液08を60.3質量部を混合し、充分に攪拌してドープを調製した。レターデーショ ン調整剤Aの添加量はセルロースアセテート100質量部に対して10質量部であった。 バンド上に流延したところ、乾燥していくに伴い、フィルム表面に白味を帯びた結晶状の 化合物が析出してきたため、フィルム作製を中止した。

[0245]

比較例 5

[セルロースアシレートフイルムB5の作成]

ミキシングタンクに、前述のレターデーション制御剤Bを20質量部、メチレンクロラ イド87質量部およびメタノール13質量部を投入し、加熱しながら攪拌して、レターデ ーション制御剤溶液09を調製した。

実施例1のセルロースアセテート溶液474質量部にレターデーション制御(上昇)剤 溶液 0 9 を 1 2. 1 質量部を混合し、充分に攪拌してドープを調製した。レターデーショ ン調整剤Bの添加量はセルロースアセテート100質量部に対して2質量部であった。

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量32%で、テンター延伸機 で横延伸した。延伸倍率は26%とし、実施例1と同様にしてセルロースアセテートフィ ルム (厚さ:92μm) を作成した。

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA (2 1 ADH、王子計測機器 (株)製)を用いて、波長590nmにおけるReレターデーション値およびRthレターデー ション値を測定した。また、波長分散形状、25℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、 寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0246]

比較例 6

[セルロースアシレートフイルムB6の作成]

延伸倍率を30%としたこと以外は比較例5と同様にして、セルロースアセテートフイ ルム(厚さ:90 μ m)を作製した。作製したセルロースアセテートフイルムについて、 KOBRA (21ADH、王子計測機器(株)製)を用いて、波長590nmにおけるReレター デーション値およびRthレターデーション値を測定した。また、波長分散形状、25℃で の光学性能の湿度依存性、透湿度、寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0247]

比較例7

[セルロースアシレートフイルムB7の作成]

実施例1のセルロースアセテート溶液474質量部にレターデーション制御(上昇)剤 溶液09を36.2質量部を混合し、充分に攪拌してドープを調製した。レターデーショ ン調整剤Bの添加量はセルロースアセテート100質量部に対して6質量部であった。

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量34%で、テンター延伸機 で横延伸した。延伸倍率は26%とし、実施例1と同様にしてセルロースアセテートフィ ルム (厚さ:93μm) を作成した。

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA (2 1 ADH、王子計測機器 (株)製)を用いて、波長590nmにおけるReレターデーション値およびRthレターデー ション値を測定した。また、波長分散形状、25℃での光学性能の湿度依存性、透湿度、 寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0248]

比較例8

[セルロースアシレートフイルムB8の作成]

延伸倍率を30%としたこと以外は比較例7と同様にして、セルロースアセテートフイ

ルム(厚さ: $91\,\mu$ m)を作製した。作製したセルロースアセテートフイルムについて、 KOBRA(21 ADH、王子計測機器(株)製)を用いて、波長 590 n mにおける R e レターデーション値および R thレターデーション値を測定した。また、波長分散形状、 $25\,^\circ$ での光学性能の湿度依存性、透湿度、寸度変化率を測定した。結果を表 1 に示す。

[0249]

比較例 9

[セルロースアシレートフイルム B 9 の作成]

ミキシングタンクに、前述のレターデーション制御剤Aを10質量部、レターデーション制御剤Cを10質量部、メチレンクロライド87質量部およびメタノール13質量部を投入し、加熱しながら攪拌して、レターデーション制御剤溶液10を調製した。

実施例1のセルロースアセテート溶液474質量部にレターデーション制御(上昇)剤溶液10を45.2質量部を混合し、充分に攪拌してドープを調製した。レターデーション調整剤Aの添加量はセルロースアセテート100質量部に対して3.75質量部、レターデーション調整剤Cの添加量はセルロースアセテート100質量部に対して3.75質量部であった。

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量 28%で、テンター延伸機で横延伸した。延伸倍率は 26%とし、実施例 1と同様にしてセルロースアセテートフィルム(厚さ: 91μ m)を作成した。

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA(2 1 ADH、王子計測機器(株)製)を用いて、波長 5 9 0 n mにおける R e レターデーション値および R thレターデーション値を測定した。また、波長分散形状、 2 5 $\mathbb C$ での光学性能の湿度依存性、透湿度、寸度変化率を測定した。結果を表 1 に示す。

[0250]

比較例10

[セルロースアシレートフイルム B 1 0 の作成]

ミキシングタンクに、前述のレターデーション制御剤 B を 10 質量部、レターデーション制御剤 D を 10 質量部、メチレンクロライド 87 質量部およびメタノール 13 質量部を投入し、加熱しながら攪拌して、レターデーション制御剤溶液 11 を調製した。

実施例1のセルロースアセテート溶液474質量部にレターデーション制御(上昇)剤溶液10を36.2質量部を混合し、充分に攪拌してドープを調製した。レターデーション調整剤Bの添加量はセルロースアセテート100質量部に対して3質量部、レターデーション調整剤Dの添加量はセルロースアセテート100質量部に対して3質量部であった

バンド上に流延した後、剥ぎ取り、延伸開始時の残留溶剤量33%で、テンター延伸機で横延伸した。延伸倍率は26%とし、実施例1と同様にしてセルロースアセテートフィルム(厚さ:92 μ m)を作成した。

作製したセルロースアセテートフイルムについて、KOBRA(2 1 ADH、王子計測機器(株)製)を用いて、波長590nmにおけるReレターデーション値およびRthレターデーション値を測定した。また、波長分散形状、25 $^{\circ}$ での光学性能の湿度依存性、透湿度、寸度変化率を測定した。結果を表1に示す。

[0251]

【表1】

表1																		
	レターデーション制御剤添加量(対 綿)			延 (延 延伸 伸			RR	R OR		Rth波長分散		25℃湿度 依存性		∩ 2 g 5	寸度変化率 (%)			
))	割レ	剤レ	剃レ	剤レ	倍(~ 開	後	_	h	1	伸/	- R	- R	- R	- R	プでし	9	6
))	A S	ВЯ	CS	DS	率	始	膜	n	1	R	i R	R e	n R t	Re	n R t	m 9	ŏ	o l
]]	i j	1		- Ĭ I	_	睛	厚	m	n	t	96 t		mth	e 1	mth	20	°C	°c
]]	デ	デ	デ	デ	倍	殘	~	Ü	m	h	当h	4 0	~ h 7	8 0	Chil	. 96	D	9
))	1	デ	l í '	l [] 1		留	и		Ü		た変	0.0	4 0	0 %	8 0	2选	r	o l
) 1	シ	シ	اد	シ	i	溶	m		1		り化	0	001	%	0 %	4温	y	96
()	э.	∍	3	3		割	Ü		1		○量 .	_	0	~	96	h座	1	
{	ン	ン	ادا	レン	[[1		1			n]	n	'	r		1
1	制	制	制	制	. 1		- (1			m		m) [<u> </u>		
	御	御	御	御								`		~				
実施例1	3,0%	3.0%			26	32	92	51	129	0.40		-3	-10	5		185	-0.07	-0.02
実施例2	3,0%	3.0%			30	32	90	59	131	0.45	0.013	-5	-12	6		180	-0.09	-0.03
実施例3	3.0%	3.0%			26	32	80	45	112	0.40		-2	-8	5		195	~0.08	-0.03
実施例4	2.6%	2.6%			26	32	92	40	141	0.28	0.012	-2	-8	5		190	~0.07	-0.02
実施例5	1.0%	6.0%			25	18	92	40	241	0.17	0.011	-8	-20	6		200	~0.07	-0.04
実施例6	2.0%	3.0%			26	34	93	58	128	0.45	0.014	-6	-15	5		180	-0.07	-0.03
実施例7	5.0%	2.0%	1 50		26	30	91	45	138	0.33	0.012	-1	-3	4		180	-0.10	-0.04
実施例8	1.5%	3.0%	1.5%	7 50	26	32	90	52	132	0.39	0.013	-3	-10	5		185	-0.08	-0.03
実施例9	3.0%	1.5%	2.0%	1.5%	26	33	93 92	49 54	128 138	0.38	0.013	-2 -4	-9 -12	- 6		190 185	~0.08 ~0.09	-0.03 -0.03
実施例10	0.5%	3.0%	3.0%		26	31 32		52	130	0.39		- 4	-15	5 5		185	-0.08	-0.03
実施例11	2.5%	2.5%			26 23	32	80		125	0.40	0.013	-3	-7		25	200	-0.13	-0.03
<u>実施例12</u> 実施例13	1.2%	0.8% 1.2%			18	28	80 80	45 40	120	0.33		-2		<u>6</u>		180	-0.13	-0.05
実施例14	2.9%	1.6%			30	34	70	60	155	0.39	0.012	-4	~12	12	45	195	-0.06	-0.12
実施例15	2.3%	1.2%			28	32	70	50	115	0.43		-3	-6	5		180	~0.07	-0.05
実施例16	1.2%	0.8%			30	30	90	35	130	0.27	0.012	-1	~10	2		190	-0.12	-0.03
実施例17	2.4%	1.6%			25	28	80	50	130	0.38	0.012	-3	~11	8		195	-0.08	-0.12
実施例18	1.6%	1.4%			20	31	90	35	162	0.22	0.011	-1	-13	3		185	-0.02	-0.1
実施例19	2.5%	2.5%			25	30	110	50	260	0.19	0.011	-18	-30	22		200	-0.1	-0.07
実施例20	3.0%	2.0%	-		21	34	80	60	220	0.27	0.012	-20	-43	6		220	-0.06	-0.05
実施例21	1.4%	0.6%			25	30	70	74	260	0.28	0.012	-6	-16	18		180	-0.13	-0.09
実施例22	1.6%	2.4%	1		28	28	80	50	240	0.21	0.011	-22	-46	13		196	-0.11	-0.05
実施例23	1.8%	1.2%			25	32	90	60	260	0.23	0.012	-2	-5	9		220	-0.04	-0.12
実施例24	3.0%	2.0%	<u> </u>		23	28	100	70	240	0.29	0.012	~15	-35	5		210	~0.08	-0.03
実施例25	3.0%	2.0%		·	26	28	100	80	246	0.33	0.013	-14	-32	6		210	-0.0B	-0.03
実施例26	3.0%	3.0%			32	34	80	60	240	0.25	0.012	-13	-25	16	38	180	-0.1	-0.06
実施例27	3.8%	2.5%			25	30	90	70	220	0.32	0.012	-8	-18	20	56	196	~0.06	-0.11
実施例28	4.6%	2.0%	l		20	32	60	50	220	0.23	0.012	-5	-10	12	24	185	~0.04	-0.09
比較例1	6.0%	1		_	26	28	93	27	138	0.20	0.007	0.2	2	6	22	160	~0.09	-0.04
比較例2	7.5%			-	26	26	90	34	145	0.23	0.008	0.5	4			155	~0.10	-0.05
比較例3	7.5%			1	30	26	89	38	149	0.26	0.008	0.6	5	7	24	155	~0.11	-0.06
比較例4	10.0%			_					-					7	_ =		-	
比較例5		2.0%			26	32	92	22	111	0.20	0.004	-2	-8	7		190	-0.07	-0.02
比較例6		2.0%			30	32	90	26	120	0.22	0.004	-2	-8	8		185	~0.08	-0.03
比較例7	_	6.0%			26	34	93	38	190	0.20	0.005	-5	-13	10			-0.08	-0.03
比較例B	=	6.0%			30	34	91	43	198	0.22	0.005	6		10		200	~0.09	-0.04
比較例9	3.75%		3.75%	_	26	28	91	32	148	0.22	0.008	-0.2		5		190	~0.09	-0.05
比較例10		3.0%		3.0%	26	33	92	38	192	0.20	0.005	-5	-12	10	38	200	~0.08	-0.03

[0252]

実施例29

「偏光板A1~A28の作製」

延伸したポリビニルアルコールフイルムにヨウ素を吸着させて偏光膜を作製した。

作製したセルロースアシレートフイルム1にケン化処理を行い、ポリビニルアルコール系接着剤を用いて、偏光膜の片側に貼り付けた。なお、ケン化処理は以下のような条件で行った。

1.5 Nの水酸化ナトリウム水溶液を調製し、55 \mathbb{C} に保温した。0.01 Nの希硫酸水溶液を調製し、35 \mathbb{C} に保温した。作製したセルロースアシレートフィルムA1を上記の水酸化ナトリウム水溶液に2分間浸漬した後、水に浸漬し水酸化ナトリウム水溶液を十分に洗い流した。次いで、上記の希硫酸水溶液に1分間浸漬した後、水に浸漬し希硫酸水溶液を十分に洗い流した。 最後に試料を120 \mathbb{C} で十分に乾燥させた。

酸化処理後のセルロースアセテートフィルムについて、表面エネルギーを測定し求めた 結果を表2に示す。

市販のセルローストリアセテートフイルム(フジタックTD80UF、富士写真フイルム(株)製)に同様のケン化処理を行い、ポリビニルアルコール系接着剤を用いて、偏光膜の、作成したセルロースアセテートフィルムA1とは反対側に貼り付けた。

[0253]

偏光膜の透過軸と作成したセルロースアセテートフイルムの遅相軸とは平行になるよう 出証特2005-3029028 に配置した。また、偏光膜の透過軸と市販のセルローストリアセテートフイルムの遅相軸 とは、直交するように配置した。

このようにして偏光板A1を作製した。同様にしてセルロースアシレートフイルムA2 ~A28を用いた偏光板A2~A28を作製した。セルロースアシレートフイルムA2~ A28についても鹸化処理後のセルロースアセテートフイルムについて、表面エネルギー を測定し求めた結果を表2に示す。

作製した偏光板の光学性能(単板透過率、偏光度)を、島津自記分光光度計UV310 0にて測定したのち、60℃90%RHの恒温恒湿器に偏光板を静置し、500時間経時 させた。経時後のセルロースアセテートフイルムについても同様に光学性能を測定し、偏 光度の変化を求めた。結果を表3に示す。

[0254]

比較例11

[偏光板B1~B10の作製]

実施例29と同様にして、セルロースアシレートフイルムB1~B10を用いた偏光板 B1~B10を作製した。セルロースアシレートフイルムB1~B10についても鹸化処 理後のセルロースアセテートフイルムについて、表面エネルギーを測定し求めた結果を表 2 に示す。

実施例12と同様にして求めた偏光度変化の値を表3に示す。

[0255]

【表2】

表2		
		表
.		直
		エ
	-	ネー
	1	ル
	- 1	ギー
		エネルギー
	l	-
	1	$\overline{}$
		m
		m N
		/
		m
セ	A1	64
しんし	A2	64
161	A3	64
171	A4	63
ースト	A4 A5	66
ア	A6	62
しシト	A7	65
ーレー	A7 A8 A9	65
[A9	63
	AIU	64
ーラー	A11	64
1	A12	57
ルル	A13	65
ルロースアシレートフィルム	A14	59
	A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20	68
1	A16	59
	A17	62
	A18	68
	A19	58
	A20	60
	A21	65
	A22	59
1	A23	64
1	A24	57
	A25	57
ļ	A26	60
	A27	69
1	A28	68
1	B1	66
1	B2	67
	B3	67
-	B4	
	B5	59
	B6	59
-	B7	60
ļ	B8	60
	B9	67
	B10	60

[0256]

【表3】

表3_		
		偏光度変化(%)60℃95%500時間
偏	A1	-0.55
光	A2	-0.63
板	A3	-0.54
1,1,1	A4	-0.57
ì	A5	-0.82
	A6	-0.56
	A7	-0.79
	A8	-0.58
1	A9	-0.57
1	A10	-0.55
l	A11	-0.55
	A12	-1.2
ļ	A13	-1.45
ł	A14	-0.67
1	A15	-1.21
1	A16	-0.25
1	A17	-0.47
1	A18	-1.34
1	A19	-0.7
-	A20	-0.8
1	A21	-1.2
	A22	-0.6
	A23	-0.9
- {	A24	-0.4
	A25	-0.5
1	A26	-0.8
- {	A27	-1.9
	A28	-1.8
l	<u>B1</u>	-0.55
- [B2	-0.89
-	B3	-0.13
	B4_	-
1	B5	-0.63
	B6	-0.88
	B7	-0.72
	B8	-0.93
-	B9	-0.92
	B10	-0.11

[0257]

実施例30

[偏光板C1および液晶表示装置の作成と評価]

(光散乱層用塗布液の調製)

ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレートの 混合物 (PETA、日本化薬 (株) 製) 50gをトルエン38.5gで希釈した。更に、重合 開始剤(イルガキュア184、チバ・スペシャルティ・ケミカルズ(株)製)を2g添加 し、混合攪拌した。 この溶液を塗布、紫外線硬化して得られた塗膜の屈折率は1.51 であった。

[0258]

さらにこの溶液にポリトロン分散機にて10000rpmで20分分散した平均粒径3 . 5 μ mの架橋ポリスチレン粒子(屈折率 1 . 6 0 、S X - 3 5 0 、綜研化学(株)製) の30%トルエン分散液を1.7gおよび平均粒径3.5μmの架橋アクリルースチレン 粒子(屈折率1.55、綜研化学(株)製)の30%トルエン分散液を13.3g加え、 最後に、フッ素系表面改質剤(FP-1) 0. 75g、シランカップリング剤(KBM-5103、信越化学工業(株)製)を10gを加え、完成液とした。

上記混合液を孔径30μmのポリプロピレン製フィルターでろ過して光散乱層の塗布液 を調製した。

[0259]

(低屈折率層用塗布液の調製)

屈折率1.42の熱架橋性含フッ素ポリマー(JN-7228、固形分濃度6%、JS R (株) 製) 13g、シリカゾル (シリカ、MEK-STの粒子サイズ違い、平均粒径4 5 n m、固形分濃度 3 0 %、日産化学(株)製) 1. 3 g、ゾル液a 0. 6 g およびメチ ルエチルケトン5g、シクロヘキサノ0.6gを添加、攪拌の後、孔径1μmのポリプロ ピレン製フィルターでろ過して、低屈折率層用塗布液を調製した。

[0260]

(反射防止層付き透明保護膜01の作製)

80 μ mの厚さのトリアセチルセルロースフイルム(TAC-TD80U、富士写真フ イルム(株)製)をロール形態で巻き出して、上記の機能層(光散乱層)用塗布液を線数 180本/インチ、深度40μmのグラビアパターンを有する直径50mmのマイクログ ラビアロールとドクターブレードを用いて、グラビアロール回転数30rpm、搬送速度 30m/分の条件で塗布し、60℃で150秒乾燥の後、さらに窒素パージ下で160W / c mの空冷メタルハライドランプ(アイグラフィックス(株)製)を用いて、照度40 $0\,\mathrm{mW/c\,m^2}$ 、照射量 $2\,5\,0\,\mathrm{m\,J/c\,m^2}$ の紫外線を照射して塗布層を硬化させ、厚さ 6μmの機能層を形成し、巻き取った。

該機能層(光散乱層)を塗設したトリアセチルセルロースフイルムを再び巻き出して、 該調製した低屈折率層用塗布液を線数180本/インチ、深度40μmのグラビアパター ンを有する直径50mmのマイクログラビアロールとドクターブレードを用いて、グラビ アロール回転数30rpm、搬送速度15m/分の条件で塗布し、120℃で150秒乾 燥の後、更に140℃で8分乾燥させてから窒素パージ下で240W/cmの空冷メタル ハライドランプ(アイグラフィックス(株)製)を用いて、照度400mW/cm²、照 射量900mJ/cm²の紫外線を照射し、厚さ100nmの低屈折率層を形成し、巻き 取った。

[0261]

(偏光板C1の作製)

延伸したポリビニルアルコールフイルムにヨウ素を吸着させて偏光膜を作製した。 作製した反射防止層付き透明保護膜01に実施例29と同様のケン化処理を行い、ポリ ビニルアルコール系接着剤を用いて、偏光膜の片側に貼り付けた。

実施例1で作製したセルロースアセテートフイルムA1に実施例29と同様のケン化処 理を行い、ポリビニルアルコール系接着剤を用いて、偏光膜の反対側に貼り付けた。

[0262]

偏光膜の透過軸と実施例1で作製したセルロースアセテートフイルムの遅相軸とは平行 になるように配置した。偏光膜の透過軸と市販のセルローストリアセテートフイルムの遅 相軸とは、直交するように配置した。このようにして偏光板C1を作製した。

分光光度計(日本分光(株)製)を用いて、380~780 nmの波長領域において、 入射角5°における分光反射率を測定し、450~650 nmの積分球平均反射率を求め たところ、2.3%であった。

実施例1の代わりに実施例2乃至18で作成したセルローストリアセテートフイルムか らも同様にして偏光板C2乃至C18を作製した。

[0263]

実施例31

(ハードコート層用塗布液の調製)

トリメチロールプロパントリアクリレート (TMPTA、日本化薬(株)製) 750. 0重量部に、重量平均分子量3000のポリ(グリシジルメタクリレート)270.0重 量部、メチルエチルケトン730.0g、シクロヘキサノン500.0g及び光重合開始 剤(イルガキュア184、日本チバガイギー(株)製)50.0gを添加して攪拌した。 孔径 0. 4 μmのポリプロピレン製フィルターで濾過してハードコート層用の塗布液を調 製した。

[0264]

(二酸化チタン微粒子分散液の調製)

二酸化チタン微粒子としては、コバルトを含有し、かつ水酸化アルミニウムと水酸化ジ ルコニウムを用いて表面処理を施した二酸化チタン微粒子(MPT-129、石原産業(株)製)を使用した。

この粒子257.1gに、下記分散剤38.6g、およびシクロヘキサノン704.3 gを添加してダイノミルにより分散し、重量平均径70nmの二酸化チタン分散液を調製 した。

[0265]【化20】

[0266]

(中屈折率層用塗布液の調製)

上記の二酸化チタン分散液88.9gに、ジペンタエリスリトールペンタアクリレート とジペンタエリスリトールヘキサアクリレートの混合物(DPHA)58.4g、光重合 開始剤(イルガキュア907)3.1g、光増感剤(カヤキュアーDETX、日本化薬(株)製)1.1g、メチルエチルケトン482.4gおよびシクロヘキサノン1869. 8gを添加して攪拌した。十分に攪拌ののち、孔径 0. 4 μmのポリプロピレン製フィル ターで濾過して中屈折率層用塗布液を調製した。

[0267]

(高屈折率層用塗布液の調製)

上記の二酸化チタン分散液586.8gに、ジペンタエリスリトールペンタアクリレー トとジペンタエリスリトールヘキサアクリレートの混合物(DPHA、日本化薬(株)製) 47.9g、光重合開始剤(イルガキュア907、日本チバガイギー(株)製)4.0 g、光増感剤(カヤキュアーDETX、日本化薬(株)製) 1.3g、メチルエチルケト ン455.8g、およびシクロヘキサノン1427.8gを添加して攪拌した。孔径0. 4μmのポリプロピレン製フィルターで濾過して高屈折率層用の塗布液を調製した。

[0268]

(低屈折率層用塗布液の調製)

本発明に係る共重合体(P-1)をメチルイソブチルケトンに7質量%の濃度になるよ うに溶解し、末端メタクリレート基含有シリコーン樹脂X-22-164C(信越化学(株)製)を固形分に対して3%、光ラジカル発生剤イルガキュア907(商品名)を固形 分に対して5質量%添加し、低屈折率層用塗布液を調製した。

[0269] 【化21】

P-1

[0270]

(反射防止層付透明保護膜02の作製)

膜厚80μmのトリアセチルセルロースフィルム(TD-80UF、富士写真フイルム (株) 製)上に、ハードコート層用塗布液をグラビアコーターを用いて塗布した。100 ℃で乾燥した後、酸素濃度が1.0体積%以下の雰囲気になるように窒素パージしながら 160W/cmの空冷メタルハライドランプ(アイグラフィックス(株)製)を用いて、 照度400mW/cm²、照射量300m J/cm²の紫外線を照射して塗布層を硬化さ せ、厚さ8μmのハードコート層を形成した。

ハードコート層の上に、中屈折率層用塗布液、高屈折率層用塗布液、低屈折率層用塗布 液を3つの塗布ステーションを有するグラビアコーターを用いて連続して塗布した。

[0271]

中屈折率層の乾燥条件は100℃、2分間とし、紫外線硬化条件は酸素濃度が1.0体 積%以下の雰囲気になるように窒素パージしながら180W/cmの空冷メタルハライド ランプ (アイグラフィックス (株) 製)を用いて、照度400mW/cm²、照射量40 0 m J / c m² の照射量とした。硬化後の中屈折率層は屈折率1.630、膜厚67 n m であった。

[0272]

高屈折率層および低屈折率層の乾燥条件はいずれも90℃、1分の後、100℃、1分 とし、紫外線硬化条件は酸素濃度が1.0体積%以下の雰囲気になるように窒素パージし ながら240W/cmの空冷メタルハライドランプ(アイグラフィックス(株)製)を用 いて、照度600mW/cm²、照射量600mJ/cm²の照射量とした。

硬化後の高屈折率層は屈折率1.905、膜厚107nm、低屈折率層は屈折率1.4 40、膜厚85 n mであった。このようにして、反射防止層付き透明保護膜02を作製し た。

[0273]

(偏光板D1の作製)

反射防止層付き透明保護膜 0 1 の代わりに反射防止層付き透明保護膜 0 2 を用いた以外 は実施例30と同様にして偏光板D1を作製した。

分光光度計(日本分光(株)製)を用いて、380~780 nmの波長領域において、 入射角5°における分光反射率を測定し、450~650 nmの積分球平均反射率を求め たところ、0.4%であった。

実施例1の代わりに実施例2乃至18で作成したセルローストリアセテートフイルムか らも同様にして偏光板D2乃至D18を作製した。

[0274]

比較例 1 2

(偏光板E1の作製)

実施例1で作製したセルロースアセテートフイルムA1の変わりに、比較例1で作製し たセルロースアセテートフイルムB1を用いた以外は実施例30と同様に偏光板を作製し た。また、比較例2乃至10で作製したセルロースアセテートフイルムを用いて同様に偏 光板E2乃至E10を作製した。

[0275]

比較例 1 3

(偏光板F1の作製)

実施例1で作製したセルロースアセテートフイルムA1の変わりに、比較例1で作製し たセルロースアセテートフイルムB1を用いた以外は実施例31と同様に偏光板を作製し た。また、比較例2乃至10で作製したセルロースアセテートフイルムを用いて同様に偏 光板F2乃至F10を作製した。

[0276]

実施例32

垂直配向型液晶セルを使用した液晶表示装置(富士通(株)製)に設けられている一対 の偏光板および一対の光学補償シートの代わりに、実施例1作製した光学補償シートを使 用し、実施例29で作製した偏光板を、実施例1で作製したセルロースアセテートフィル ムが液晶セル側となるように粘着剤を介して、観察者側およびバックライト側に一枚ずつ 貼り付けた。観察者側の偏光板の透過軸が上下方向に、そして、バックライト側の偏光板 の透過軸が左右方向になるように、クロスニコル配置とした。

作製した液晶表示装置を観察した結果、正面方向および視野角方向もニュートラルな黒 表示が実現できていた。また、測定機(EZ-Contrastl60D、ELDIM社製)を用 いて、黒表示(L1)から白表示(L8)までの8段階で視野角(コントラスト比が10 以上で黒側の階調反転のない範囲)を測定した。

下記表4に示したとおり、本発明の偏光板を具備することにより広い視野角が実現でき ていた。

実施例2至18で作製した光学補償シートを使用して作製した偏光板を使った場合につ いても同様の結果が得られた。

[0277]

実施例 3 3

垂直配向型液晶セルを使用した液晶表示装置(富士通(株)製)に設けられている一対 の偏光板および一対の光学補償シートの代わりに、実施例1で作製した光学補償シートを 使用し、実施例30で得た偏光板を実施例1で作製したセルロースアセテートフイルムが 液晶セル側となるように粘着剤を介して、観察者側およびバックライト側に一枚ずつ貼り 付けた。観察者側の偏光板の透過軸が上下方向に、そして、バックライト側の偏光板の透 過軸が左右方向になるように、クロスニコル配置とした。

作製した液晶表示装置を観察した結果、正面方向および視野角方向もニュートラルな黒 表示が実現できていた。また、測定機(EZ-Contrast160D、ELDIM社製)を用 いて、黒表示 (L1) から白表示 (L8) までの8段階で視野角 (コントラスト比が10 以上で黒側の階調反転のない範囲)を測定した。

下記表4に示したとおり、本発明の偏光板を具備することにより広い視野角が実現でき ていた。

実施例2乃至18で作製した光学補償シートを使用して作製した偏光板を使った場合につ いても同様の結果が得られた。

[0278]

実施例34

垂直配向型液晶セルを使用した液晶表示装置(富士通(株)製)に設けられている一対 の偏光板および一対の光学補償シートの代わりに、実施例1で作製した光学補償シートを 使用し、実施例31で作製した偏光板を、実施例1で作製したセルロースアセテートフイ

ルムが液晶セル側となるように粘着剤を介して、観察者側およびバックライト側に一枚ず つ貼り付けた。観察者側の偏光板の透過軸が上下方向に、そして、バックライト側の偏光 板の透過軸が左右方向になるように、クロスニコル配置とした。

作製した液晶表示装置を観察した結果、正面方向および視野角方向もニュートラルな黒 表示が実現できていた。また、測定機(EZ-Contrast160D、ELDIM社製)を用 いて、黒表示 (L1) から白表示 (L8) までの8段階で視野角 (コントラスト比が10 以上で黒側の階調反転のない範囲)を測定した。

下記表4に示したとおり、本発明の偏光板を具備することにより広い視野角が実現でき ていた。

実施例2乃至18で作製した光学補償シートを使用して作製した偏光板を使った場合に ついても同様の結果が得られた。

[0279]

実施例35

垂直配向型液晶セルを使用した液晶表示装置(富士通(株)製)に設けられている一対 の偏光板および一対の光学補償シートの代わりに、実施例19で作製した光学補償シート を使用し、実施例29で作製した偏光板を、実施例19で作製したセルロースアセテート フイルムが液晶セル側となるように粘着剤を介して、バックライト側に一枚貼り付けた。 観察者側の偏光板には、視野角補償板のない市販の偏光板(HLC2-5618、サンリ ッツ(株)製)を一枚貼り付けた。観察者側の偏光板の透過軸が上下方向に、そして、バ ックライト側の偏光板の透過軸が左右方向になるように、クロスニコル配置とした。

作製した液晶表示装置を観察した結果、正面方向および視野角方向もニュートラルな黒 表示が実現できていた。また、測定機(EZ-Contrast160D、ELDIM社製)を用 いて、黒表示 (L1) から白表示 (L8) までの8段階で視野角 (コントラスト比が10 以上で黒側の階調反転のない範囲)を測定した。

下記表4に示したとおり、本発明の偏光板を具備することにより広い視野角が実現でき ていた。

実施例20至28で作製した光学補償シートを使用して作製した偏光板を使った場合に ついても同様の結果が得られた。

[0280]

比較例14

垂直配向型液晶セルを使用した液晶表示装置(VL-1530S、富士通(株)製)に ついて、測定機(E Z - Contrast 1 6 0 D、E L D I M社製)を用いて、黒表示(L 1) から白表示 (L8) までの8段階で視野角を測定した。結果を表4に示す。本発明の偏光 板を用いた場合と比較して視野角が狭いことが分かる。

[0281]

比較例 1 5

垂直配向型液晶セルを使用した液晶表示装置(富士通(株)製)に設けられている一対 の偏光板および一対の光学補償シートの代わりに、比較例1で作製したセルロースアセテ ートフイルムを用いて比較例11で作製した偏光板を、比較例1で作製したセルロースア セテートフイルムが液晶セル側となるように粘着剤を介して、観察者側およびバックライ ト側に一枚ずつ貼り付けた。観察者側の偏光板の透過軸が上下方向に、そして、バックラ イト側の偏光板の透過軸が左右方向になるように、クロスニコル配置とした。

作製した液晶表示装置を観察した結果、正面方向は黒表示が実現できていたが、視野角 方向は本発明に劣っていた。また、測定機(EZ-Contrast160D、ELDIM社製) を用いて、黒表示(L1)から白表示(L8)までの8段階で視野角(コントラスト比が 10以上で黒側の階調反転のない範囲)を測定した。結果を表4に示す。本発明の偏光板 を用いた場合と比較して視野角が狭いことが分かる。

比較例2乃至10で作製した偏光板を使用した場合にも本発明の偏光板を用いた場合と 比較して視野角が狭いことが分かった。

[0282]

比較例 1 6

垂直配向型液晶セルを使用した液晶表示装置(富士通(株)製)に設けられている一対の偏光板および一対の光学補償シートの代わりに、比較例1で作製したセルロースアセテートフイルムを用いて比較例12で作製した偏光板を、比較例1で作製したセルロースアセテートフイルムが液晶セル側となるように粘着剤を介して、観察者側およびバックライト側に一枚ずつ貼り付けた。観察者側の偏光板の透過軸が上下方向に、そして、バックライト側の偏光板の透過軸が左右方向になるように、クロスニコル配置とした。

作製した液晶表示装置を観察した結果、正面方向はニュートラルな黒表示が実現できていたが、視野角方向は本発明に劣っていた。また、測定機(EZ-Contrast160D、ELDIM社製)を用いて、黒表示(L1)から白表示(L8)までの8段階で視野角(コントラスト比が10以上で黒側の階調反転のない範囲)を測定した。結果を表4に示す。本発明の偏光板を用いた場合と比較して視野角が狭いことが分かる。

比較例2乃至10で作製した偏光板を使用した場合にも本発明の偏光板を用いた場合と 比較して視野角が狭いことが分かった。

[0283]

比較例 1 7

垂直配向型液晶セルを使用した液晶表示装置(富士通(株)製)に設けられている一対の偏光板および一対の光学補償シートの代わりに、比較例1で作製したセルロースアセテートフイルムを用いて比較例13で作製した偏光板を、比較例1で作製したセルロースアセテセテートフイルムが液晶セル側となるように粘着剤を介して、観察者側およびバックライト側に一枚ずつ貼り付けた。観察者側の偏光板の透過軸が上下方向に、そして、バックライト側の偏光板の透過軸が左右方向になるように、クロスニコル配置とした。

作製した液晶表示装置を観察した結果、正面方向はニュートラルな黒表示が実現できていたが、視野角方向は本発明に劣っていた。また、測定機(EZ-Contrast160D、ELDIM社製)を用いて、黒表示(L1)から白表示(L8)までの8段階で視野角(コントラスト比が10以上で黒側の階調反転のない範囲)を測定した。結果を表4に示す。本発明の偏光板を用いた場合と比較して視野角が狭いことが分かる。

比較例2乃至10で作製した偏光板を使用した場合にも本発明の偏光板を用いた場合と 比較して視野角が狭いことが分かった。

[0284]

比較例 1 8

実施例 19 で作製したセルロースアセテートフィルムの代わりに、比較例 8 で作製したセルロースアセテートフイルムを用いた以外は、実施例 35 と同様にして、液晶表示層を作製した。作製した液晶表示装置を観察した結果、正面方向ではニュートラルな黒表示が実現できていたが、視野角方向では本発明に劣っていた。また、測定機(EZ-Contrast 160D、ELDIM社製)を用いて、黒表示(L1)から白表示(L8)までの 8 段階で視野角(コントラスト比が 10 以上で黒側の階調反転のない範囲)を測定した。結果を表 4 に示す。本発明の偏光板を用いた場合と比較して視野角が狭いことが分かる。

[0285]

【表4】

表4

液晶	視野角					
表示装置	透過軸方向	透過軸から45°の方向				
実施例32	>8 0°	>8 0°				
実施例33	>80°	>8 0°				
実施例34	>80°	>80°				
実施例35	>80°	>80°				
比較例14	>80°	4 4°				
比較例15	7 4°	68°				
比較例16	75°	7 0°				
比較例17	75°	7 0°				
比較例18	67°	5 7°				

[0286]

実施例36

(ОСВ型 (ベンド配向) 液晶セルの作製)

TFT電極付きのガラス基板に、ポリイミド膜を配向膜として設け、配向膜にラビング処理を行った。得られた二枚のガラス基板をラビング方向が平行となる配置で向かい合わせ、セルギャップ(二枚のガラス基板の隙間)にフッ素系液晶化合物(物性値は Δ n=0.16、 Δ ε=9.3、k11=13.4pN、k22=7.4pN、k33=14.7pN)を注入し、ベンド配向液晶セルを作製した。

(光学的位相差補償フイルムの作製)

[0287]

【表5】

表5

配向膜塗布液組成

下記の変性ポリビニルアルコール 10質量部

水

371質量部

メタノール

119質量部

グルタルアルデヒド(架橋剤) 0.5質量部

【0288】 【化22】

変性ポリビニルアルコール

[0289]

[0290]

【化23】

[0291]

延伸したポリビニルアルコールフイルムにヨウ素を吸着させて偏光膜を作製した。ポリ ビニルアルコール系接着剤を用いて、作製した光学的位相差補償フイルムのセルロースア セテートフイルム側を、セルロースアセテートフイルムの遅相軸が偏光膜の透過軸と平行 になるように、偏光膜の片側に貼り付けた。市販のセルローストリアセテートフイルム(フジタックTD80UF、富士写真フイルム(株)製)にケン化処理を行い、ポリビニル アルコール系接着剤を用いて、偏光膜の反対側に貼り付けた。このようにして偏光板を作 製した。

[0292]

得られたベンド配向セルを挟むように、作製した偏光板を二枚貼り付けた。偏光板の光 学異方性層がセル基板に対面し、液晶セルのラビング方向とそれに対面する光学異方性層 のラビング方向とが反平行となるように配置した。液晶セルに55Hzの矩形波電圧を印 加した。白表示2 V、黒表示5 Vのノーマリーホワイトモードとした。透過率の比(白表 示/黒表示)をコントラスト比として、測定機(EZ-Contrast160D、ELDIM社 製)を用いて、黒表示(L1)から白表示(L8)までの8段階で視野角を測定した。結 果を表6に示す。

[0293]

比較例 1 8

市販のセルロースアセテートフイルム(富士タックTD80、富士写真フイルム(株) 製)に、実施例36と同様にして、表面処理、配向膜と液晶分子の塗設、偏光板の作製、 OCB型液晶装置の作製を行った。作製した液晶表示装置の視野角を測定した結果を表 6 に示す。

[0294]

(液晶表示装置の評価)

実施例36、および比較例18で作製した液晶表示装置の視角特性の結果を以下に示す

[0295]

【表6】

表6

	$\Delta \mathbf{nd}$ ($\mu \mathbf{m}$)	セル厚 (μ m)	視角(上下) (°)	視角(左右) (°)
実施例36	1.92	12.0	+80/-80	+80/-80
比較例18	1.12	7.0	+60/-55	+60/-60

[0296]

実施例36で作製した液晶表示装置は、比較例18で作製した液晶表示装置に比較して 広視野角を得た。

また、実施例36で、実施例1で作製したセルロースアセテートフイルムを用いる代わ りに実施例2乃至18で作製したセルロースアセテートフイルムを用いた場合にも、同様 に広視野角が得られた。

【書類名】要約書

【要約】

【課題】セルロースアシレートフイルムのみで、液晶セルを光学的に補償する光学補償シ ートを提供する。

【解決手段】セルロースアシレートと、該セルロースアシレート100質量部に対して下 記一般式(I)で表される化合物の少なくとも一種0.01乃至20質量部および該セル ロースアシレート100質量部に対して少なくとも3つの置換基を有する環状化合物の少 なくとも一種0.01乃至20質量部とを含む光学補償シート。

【化1】

一般式(I)

$$R^{3}$$
 R^{4}
 R^{5}
 R^{6}
 R^{7}

式中、 $R^1 \sim R^7$ 、 $R^9 \sim R^{10}$ はそれぞれ独立に水素原子または置換基を表し、 $R^1 \sim R^5$ のうち少なくとも1つは電子供与性基を表す。 R^8 は水素原子、炭素数 $1\sim4$ のアルキル基、 炭素数2~6のアルケニル基、炭素数2~6のアルキニル基、炭素数2~12のアリール基、炭 素数1~12のアルコキシ基、炭素数6~12のアリールオキシ基、炭素数2~12のアルコキシ カルボニル基、炭素数2~12のアシルアミノ基、シアノ基またはハロゲン原子を表す。

【選択図】なし

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2004-273996

受付番号

5 0 4 0 1 6 0 0 7 7 7

書類名

特許願

担当官

第一担当上席

0 0 9 0

作成日

平成16年 9月27日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】

000005201

【住所又は居所】

神奈川県南足柄市中沼210番地

【氏名又は名称】

富士写真フイルム株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】

100076439

【住所又は居所】

東京都港区新橋3丁目1番10号石井ビル3階

飯田国際特許事務所

【氏名又は名称】

飯田 敏三

ž.

特願2004-273996

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000005201]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名 1990年 8月14日 新規登録 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真フイルム株式会社